SPE Signature Required for RUSH STIC Translation Branch Request Form for Translation Phone: 308-0881 Crystal Plaza ¼, Room 2C15 http://ptoweb/patents/stic/stic-transhome.htm Information in shaded areas marked with an * is required Fill out a separate Request Form for each document *U. S. Serial No.: 10/076,070 Joseph Radiquez Phone No.: 7/208.834) Coks . 5.A17 Art Unit/Org.: 3653 *Requester's Name: ___ Office Location: ___ Is this for the Board of Patent Appeals? Date of Request: ___ 8.702 *Date Needed By: _ (Please indicate a specific date) Document Identification (Select One): Note: If submitting a request for patent translation, it is not necessary to attach a copy of the document with the request. If requesting a non-patent translation, please attach a complete, legible copy of the document to be translated to this form and submit it at your EIC or a 12-146818 STIC Library 2000 - 176214 *Document No. Patent Translations Branch 1. *Country Code The world of foreign prior art to you *Publication Date Translations *Language No. of Pages _____ (filled by STIC) *Author Article Equivalent -Patents *Language Searching *Country *Type of Document Other *Country *Language To assist us in providing the most cost effective service, please answer these questions: Section 19 Will you accept an English Language Equivalent? _(Yes/No) Would you like to review this document with a translator prior to having a complete written translation? (Translator will call you to set up a mutually convenient time) Yes/No) (Translator will call you to set up a mutually convenient time) (Yes/No) Would you like a Human Assisted Machine translation? Human Assisted Machine translations provided by Derwent/Schreiber is the default for Japanese Patents 1993 onwards with an E.mae 7.30-03 Average 5-day turnaround. STIC USE ONLY **Translation** Copy/Search Date logged in:_ Processor: PTO estimated words:_ Date assigned: Number of pages: ____ Date filled: _ In-House Translation Available:



Equivalent found: (Yes/No

Doc. No.:_

Country:_

In-House Name: Translator: Priority: Assigned: Sent:

Returned:

Returned:

Contractor:



PTO 2003-4370



MACHINE-ASSISTED TRANSLATION (MAT):

(19)【発行国】

(19)[ISSUING COUNTRY]

日本国特許庁(JP)

Japan Patent Office (JP)

(12)【公報種別】

(12)[GAZETTE CATEGORY]

公開特許公報(A)

Laid-open Kokai Patent (A)

(11)【公開番号】

(11)[KOKAI NUMBER]

特開 2 0 0 0 - 1 4 6 8 1 8 Unexamined

Japanese

Patent

(P2000-146818A)

A)

(43)【公開日】

(43)[DATE OF FIRST PUBLICATION]

平成12年5月26日(200 (2000.5.26)

0.5.26

(54)【発明の名称】

(54)[TITLE of the Invention]

微粒子分級方法及び装置

Microparticle classification

method and

apparatus

(51)【国際特許分類第7版】

(51)[IPC Int. Cl. 7]

G01N 15/02

G01N 15/02

[FI]

[FI]

G01N 15/02

F

G01N 15/02

F

【審查請求】 未請求

[REQUEST FOR EXAMINATION] No

【請求項の数】 8

[NUMBER OF CLAIMS] 8

【出願形態】 〇L

[FORM of APPLICATION] Electronic

【全頁数】 9

[NUMBER OF PAGES] 9



(21)【出願番号】

(21)[APPLICATION NUMBER]

特願平10-314297

Japanese Patent Application (1998-314297)

Heisei 10-314297

(22)【出願日】

(22)[DATE OF FILING]

平成10年11月5日(199 (1998.11.5)

8. 11. 5)

(71)【出願人】

(71)[PATENTEE/ASSIGNEE]

【識別番号】

[ID CODE]

390010021

390010021

【氏名又は名称】

[NAME OR APPELLATION]

松下技研株式会社

K.K., Matsushita Research Institute

【住所又は居所】

[ADDRESS or DOMICILE]

神奈川県川崎市多摩区東三田3

丁目10番1号

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】

[NAME OR APPELLATION]

吉田岳人

Yoshida Gakuto

【住所又は居所】

[ADDRESS or DOMICILE]

神奈川県川崎市多摩区東三田3 丁目10番1号 松下技研株式 会社内

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]



【氏名】

[NAME OR APPELLATION]

牧 野 俊 晴

Makino Toshiharu

【住所又は居所】

[ADDRESS or DOMICILE]

神奈川県川崎市多摩区東三田3 丁目10番1号 松下技研株式 会社内

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】

[NAME OR APPELLATION]

鈴 木 信 靖

Suzuki Nobuyasu

【住所又は居所】

[ADDRESS or DOMICILE]

神奈川県川崎市多摩区東三田3 丁目10番1号 松下技研株式 会社内

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】

[NAME OR APPELLATION]

山田由佳

Yamada Yuka

【住所又は居所】

[ADDRESS or DOMICILE]

神奈川県川崎市多摩区東三田3 丁目10番1号 松下技研株式 会社内

(74)【代理人】

(74)[AGENT]

【識別番号】

[ID CODE]

100082692

100082692



【弁理士】

[PATENT ATTORNEY]

【氏名又は名称】 蔵合 正博

[NAME OR APPELLATION]

Kurago Masahiro

(57)【要約】

(57)[ABSTRACT of the Disclosure]

【課題】

置を提供すること。

[SUBJECT of the Invention]

減圧下で生成される粒径数nm Provide the classifier which can be highly レベルの超微粒子を高精度で分 accurate, can classify the ultrafine particle of the 級し、さらに高真空側の堆積室 particle-size the level of several nm generated 〜搬送することが可能な分級装 under reduced pressure, and can further be conveyed to the deposition chamber by the side of a high vacuum.

【解決手段】

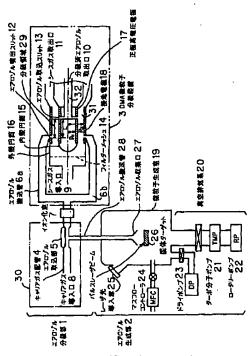
いは高く設定する。この構成で、 aerosol production range. に、エアロゾルを導入すること total pressure. ができる。

[PROBLEM to be solved]

微粒子生成室19のエアロゾル On the occasion of introducing aerosol for this 発生領域からこれを分級装置3 from the aerosol production range of the へ、エアロゾルを差圧を利用し microparticle generation chamber 19 to て導入するに際し、エアロゾル classifier 3 using pressure difference, the total 発生領域の総圧に比較して、分 pressure of the aerosol capture section 級装置側に構成されたエアロゾ comprised at the classifier side is set up equally ル取り込み部の総圧を同等ある or highly compared with the total pressure of an

エアロゾル取り込み部 5 のキャ With this composition, the static pressure of the リアガス流速を大きくすること capture section is lowered rather than the total により、取り込み部の静圧をエ pressure of an aerosol production range by アロゾル発生領域の総圧より下 enlarging the carrier gas flow rate of the aerosol げ、総圧としては同等かあるい capture section 5, aerosol can be introduced は低いエアロゾル発生領域か into the interior of a classifier with a value ら、総圧としては同等かあるい equivalent or high as a total pressure, from an は高い値をもつ分級装置内部 aerosol production range equivalent or low as a





- 1: Aerosol classification section
- 2: Aerosol generation section
- 3: DMA fine-particle classifier
- 4: Carrier gas piping
- 5: Aerosol taking-in section
- 6a: Aerosol conveyance pipe
- 7: Ionization chamber
- 8: Carrier gas inlet
- 9: Sheath gas introduction port
- 10: Classification completed aerosol output port
- 11: Sheath gas output port
- 12: Aerosol ejection slit
- 13: Aerosol taking-in slit
- 14: Filter mesh
- 15: Inner-husk cylinder
- 16: Outer-shell cylinder
- 17: Positive-electrode high-voltage electrode
- 18: Earth electrode
- 19: Fine-particle generation chamber

JP2000-146818-A



20: Evacuation -based

21: Turbo-molecular pump

22: Rotary pump

23: Dry pump

24: Mass-flow controller Pulse laser beam

25: Laser-beam introduction window

26: Solid target

27: Aerosol collection mouth 28: Aerosol conveyance pipe

29: Classification region

【特許請求の範囲】

[CLAIMS]

【請求項1】

ル発生領域の総圧に比較して、 アロゾル取り込み部の総圧が、 ゾル中微粒子に対する微粒子分 might become higher or equal. 級方法。

【請求項2】

側に構成されたエアロゾル取り

[CLAIM 1]

エアロゾル発生領域で発生され A microparticle classification method with たエアロゾルを分級装置へ差圧 respect to the microparticle in aerosol, in which を利用して導入し、微粒子を分 in introducing to a classifier the aerosol 級するに際して、前記エアロゾ produced in the aerosol production range using pressure difference, and classifying 前記分級装置側に構成されたエ microparticle, compared with the total pressure of said aerosol production range, the total 同等か或いは高くなるように設 pressure of the aerosol capture section 定したことを特徴とするエアロ comprised at said classifier side set up so that it

[CLAIM 2]

エアロゾル発生領域で発生され A microparticle classification method with たエアロゾルを分級装置へ差圧 respect to the microparticle in aerosol, in which を利用して導入し、微粒子を分 in introducing to a classifier the aerosol 級するに際して、前記分級装置 produced in the aerosol production range using pressure difference. and classifying 込み部が、特定のキャリアガス microparticle, the aerosol capture section



が流れる配管構造をしており、 微粒子に対する微粒子分級方 before and after. 法。

comprised at said classifier side is having piping かつ前後の配管の径よりも細い structure where specific carrier gas flows, and it ことを特徴とするエアロゾル中 is more slender than the diameter of piping

【請求項3】

生領域における媒質ガス種と異 pressure 微粒子に対する微粒子分級方 法。

【請求項4】

ロゾル中微粒子に対する微粒子 分級方法。

【請求項5】

[CLAIM 3]

エアロゾル発生領域で発生され A microparticle classification method with たエアロゾルを分級装置へ差圧 respect to the microparticle in aerosol, in which を利用して導入し、微粒子を分 in introducing to a classifier the aerosol 級するに際して、エアロゾル発 produced in the aerosol production range using difference, and classifying なった種類の媒質ガスが、分級 microparticle, the medium gas of a different kind 装置内部のキャリアガスもしく from the medium gas source in an aerosol はシースガスとして導入される production range is introduced as the carrier ことを特徴とするエアロゾル中 gas or sheathing gas inside a classifier.

[CLAIM 4]

エアロゾル発生領域における媒 A microparticle classification method with 質ガスの密度よりも高い密度を respect to the microparticle in aerosol of Claim 有する媒質ガスが、分級装置内 3, in which the medium gas which has a density 部のキャリアガスもしくはシー higher than the density of the medium gas in an スガスとして導入されることを aerosol production range is introduced as the 特徴とする請求項3記載のエア carrier gas or sheathing gas inside a classifier.

[CLAIM 5]

エアロゾル発生領域でエアロゾ A microparticle classification method with ルを発生する段階と、発生され respect to the microparticle in aerosol, which たエアロゾルを分級装置へ差圧 consists of the phase of producing aerosol in an を利用してエアロゾル取り込み aerosol production range, the phase which 部へ導入する段階と、エアロゾ introduces the produced aerosol to a classifier ル取り込み部へ導入されたエア to the aerosol capture section using pressure



階とから成り、

前記エアロゾルを分級装置へ導 入するに際して、前記エアロゾ ル発生領域の総圧に比較して、 アロゾル取り込み部の総圧が、 定したことを特徴とするエアロ ゾル中微粒子に対する微粒子分 級方法。

ロゾルを微粒子分級部へ搬送す difference, the phase of conveying the aerosol る段階と、微粒子を分級する段 introduced to the aerosol capture section to the microparticle classification section, and the phase of classifying a microparticle, on the occasion of introducing said aerosol to a classifier, compared with the total pressure of 前記分級装置側に構成されたエ said aerosol production range, the total pressure of the aerosol capture section 同等か或いは高くなるように設 comprised at said classifier side set up so that it might become higher or equal.

【請求項6】

とから成り、

記エアロゾル発生手段の総圧に 比較して、前記分級装置側に構 は高くなるように設定されてい ることを特徴とするエアロゾル 中微粒子に対する微粒子分級装 置。

[CLAIM 6]

ターゲット体にレーザビームを A microparticle classifier with respect to the 当ててエアロゾルを生成する手 microparticle in aerosol, which consists of 段と、生成されたエアロゾルを means to apply a laser beam to a target object 差圧を利用してエアロゾル分級 and to generate aerosol, the aerosol reception 手段へ取り込むエアロゾル取り means which receive the generated aerosol to 込み手段と、エアロゾルから微 aerosol classification means using pressure 粒子を分級する微粒子分級手段 difference, microparticle classification means to と、エアロゾルをエアロゾル取 classify a microparticle from aerosol, and the り込み手段から微粒子分級手段 aerosol feed drive means which conveys 〜搬送するエアロゾル搬送手段 aerosol from aerosol reception means to microparticle classification means, compared エアロゾル取り込み手段は、前 with the total pressure of said aerosol production means, aerosol reception means are set up so that the total pressure of the site of the 成されたエアロゾル取り込み手 aerosol reception means comprised at said 段の部位の総圧が、同等か或い classifier side may become higher or equal.

【請求項7】

[CLAIM 7]



特徴とする請求項6記載のエア before and after. ロゾル中微粒子に対する微粒子 分級装置。

エアロゾル取り込み手段は、エ A microparticle classifier with respect to the アロゾル生成手段とは分岐して microparticle in aerosol of Claim 6, in which 延び、且つエアロゾル搬送のた aerosol reception means branch with aerosol めのキャリアガスが流れるキャ generation means, and are stretch, and it リアガス配管に接続されてお connects with carrier gas piping for which the り、またエアロゾル取り込み手 carrier gas for aerosol conveyance flows, 段の取り込み部位の配管の径は moreover, the diameter of piping of the capture 前後のキャリアガス配管の径よ site of aerosol reception means is set up more りも細く設定されていることを thinly than the diameter of carrier gas piping

【請求項8】

ロゾル中微粒子に対する微粒子 分級装置。

[CLAIM 8]

微粒子分級手段は、エアロゾル A microparticle classifier with respect to the 発生領域における媒質ガス種と microparticle in aerosol of Claim 6 or 7, in which 異なった種類の媒質ガスが、微 microparticle classification means, the medium 粒子分級手段内部のキャリアガ gas of a different kind from the medium gas スもしくはシースガスとして導 source in an aerosol production range is 入されるシースガス導入配管に connected to sheathing gas introduction piping 接続されていることを特徴とす introduced as the carrier gas or sheathing gas る請求項6または7記載のエア inside microparticle classification means.

【発明の詳細な説明】

[DETAILED DESCRIPTION of the **INVENTION**]

[0001]

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、エアロゾル中の微粒

[TECHNICAL FIELD of the Invention]

This invention is a microparticle classifier which 子に対して気相で動作する微粒 operates by the gaseous phase to the 子分級装置であって、特にエア microparticle in aerosol, comprised such that it



ロゾル中の対象微粒子を荷電さ is related with the microparticle classifier of the る。

[0002]

せ、さらに静電界を印加するこ type classified using the difference of the とで、粒径に依存した移動度の mobility depending on a particle size by 差を利用して分級する形式の微 electrically charging the object microparticle in 粒子分級装置に関するものであ aerosol and further impressing an electrostatic field in particular.

[0002]

【従来の技術】

あるが、第1の従来例として、 いて述べる。これは、エアロゾ ル中の微粒子を分級するに際 静電界を印加し、微粒子の大き ンス、第28巻(1997年)、 and pp193-206 (1997).). 193頁から206頁(J. Aerosol Sci. 28, pp193-206 (1997).) に記載されている。

[0003]

Mass Spectrometory: PBMS)

[PRIOR ART]

微粒子分級装置の方式としては As a system of a microparticle classifier, there is 従来から種々のタイプのものが conventionally various type thing.

However, the electrical-mobility classifying 電気移動度分級法(Differential method (Differential Mobility Analyzing: DMA) Mobility Analyzing: DMA) につ is described as 1st prior art example.

This is the classifying method performed using impressing an electrostatic field on the occasion し、対象微粒子を荷電した後に of classifying the microparticle in aerosol after electrically charging an object microparticle, and さ(粒径)により媒質ガス中の the mobility in medium gas changing with sizes 移動度が違うことを利用して行 (particle size) of a microparticle.

う分級法である。この技術につ The detail about this technique is indicated by いての詳細は例えば、ジャーナ Journal of Aerosol Science, Volume 28 (1997), ル・オブ・エアロゾル・サイエ and 193 pages -206 pages (J. AerosolSci.28

[0003]

第2の従来例として、微粒子線 As 2nd prior art example, the microparticle line 質量分級法(Particle Beam mass classifying method (Particle Beam Mass Spectrometory: PBMS) is described.

について述べる。これは対象と From the source of a microparticle which sealed なる微粒子を封入した微粒子源 the microparticle used as object, this changes a



で微粒子を超音速線(ビーム) 化する。次に、この微粒子線に 電子線を照射することで荷電さ せ、同じく高真空中で電界を印 応じた分級を行う方式である。 この技術についての詳細は例え field in a high vacuum. ば、ジャーナル・オブ・エアロ ゾル・サイエンス、第26巻(1 995年)、745頁から756 頁 (J. Aerosol Sci. 26, pp745-756 (1995).)に記載され ている。

から、高真空中に噴出する過程 microparticle a supersonic line (beam) in the process in which it ejects in a high vacuum.

It is the system which next, performs the classification according to the mass of a microparticle by making this microparticle line 加することで、微粒子の質量に electrically charge by irradiating an electron beam, and similarly impressing an electrical

> The detail about this technique is indicated by Journal of Aerosol Science, Volume 26 (1995), and 745 pages -756 pages (J.Aerosol Sci.26 and pp745-756 (1995).).

[0004]

[0004]

題】

例では、元来大気圧のエアロゾ ルからサンプリングし分級する ガス圧が高く、最近の減圧型D MAでも50-100Torr 以上の動作圧力が必要と考えら れる。一方、機能材料化する目 的で粒径数nm(ナノメート ガス雰囲気で行うことが望まし much as possible.

【発明が解決しようとする課 [PROBLEM to be solved by the Invention]

However, in said 1st prior art example, しかしながら、上記第1の従来 development has started on the assumption that it samples and classifies from the aerosol of atmospheric pressure originally.

ことを前提に開発が始まったこ It is thought that the gas pressure of operation ともあり、分級装置内部の動作 inside a classifier is high, and the working pressure of 50 to 100 or more Torr is required also of the latest reduce pressured type DMA.

On the other hand. in order to functional-material-ize and to generate a ultrafine particle with a particle size of several ル)、特に10nm以下の超微粒 nm (nanometer), especially 10 nm or less in a 子を物理的気相中で生成するた physical gaseous phase, it is desirable to carry めには、ガス圧50Torr以 out in noble-gas atmosphere where mass is 下のできる限り質量の小さい希 small of 50 Torr or less of gas pressures, as

い。このように生成された超微 In order to use the ultrafine particle generated in



を経て、機能材料として用いる ためには、分級装置としてはよ り低圧での動作が可能なDMA が必要となってくる。何故なら、 生成領域から分級装置にエアロ ゾルを流入させるためには、差 圧導入を用いることが最も有効 だからである。また、DMAの ガスを媒質ガスとして用いるこ range as medium gas. とによって、劣化して行く傾向 を持つ。

[0005]

次に第2の従来技術によって、 粒径数nmの超微粒子を分級す るためには、超微粒子を微粒子 源からの噴出過程でビーム化す るため流体力学的レンズの設計 が困難になって来る。また、装 becomes difficult. 置の大きさに留めるかぎりは、 度になる必要がある。

[0006]

粒子を、分級・堆積のプロセス this way as a functional material passing through the process of classification deposition, DMA which the operation in low voltage can do as a classifier is needed.

> It is because it is most effective to use pressure-difference introduction in order to make a classifier flow in aerosol from a generation range.

Moreover, since the sharpness of classification 分級精度は、エアロゾル中対象 of DMA is determined by the degree of brown 微粒子のブラウン拡散の度合い diffusion of the object microparticle in aerosol, it により決定されるため、生成領 has the inclination to deteriorate, by using a 域で必要とされるような軽い希 light noble gas which is needed in a generation

[0005]

Next, by 2nd prior art, in order to classify a ultrafine particle with a particle size of several nm, since a ultrafine particle is beam-ized in the ejection process from the source of a microparticle, design of a hydrodynamic lens

置のサイズを常識的な範囲の装 Moreover, as long as the size of an apparatus is stopped in the size of the apparatus of a 分級部真空槽壁面の電気的接地 commonsense range, the electric ground が 0 . 1 ボルト (V) 以下の精 contact of a classification section vacuum tank-wall surface needs to become the accuracy below 0.1v (V).

[0006]

本発明は上記の課題に鑑みなさ This invention is made in view of the れたものであって、減圧下例え above-mentioned subject, comprised such that ば50Torr以下で生成され it aims at providing the DMA type classifier る粒径数 n m レベルの超微粒子 which can sample efficiently the ultrafine



精度の分級を行い、さらに高真 空側の堆積室へ分級済み超微粒 子を搬送することが可能な、D MA型の分級装置を提供するこ とを目的とする。

を効率よくサンプリングして高 particle of the particle-size the level of several nm generated, can perform a highly accurate classification by under reduced pressure, for example, 50 Torr or less, and can further convey a classification completed ultrafine particle to the deposition chamber by the side of a high vacuum.

[0007]

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本 発明のDMA型分級装置は、エ アロゾル発生領域からこれを分 級装置へ差圧を利用して導入す るに際し、エアロゾル発生領域 の総圧に比較して、分級装置側 に構成されたエアロゾル取り込 み部の総圧が、同等あるいは高 く設定されている。この構成で、 分級装置にエアロゾルを取り込 むためには、取り込み部のキャ リアガス流速を大きくすること により、静圧を下げる必要があ る。これにより、取り込み部の 静圧をエアロゾル発生領域の総 圧より下げることができれば、 いエアロゾル発生領域から総圧 としては同等かあるいは高い値 as a total pressure. をもつ分級装置内部に、エアロ ゾルを導入することができる。

[MEANS to solve the Problem]

In order to solve the above-mentioned subject, the DMA type classifier of this invention, on the occasion of transducing this from an aerosol production range to a classifier using pressure difference, the total pressure of the aerosol capture section constituted at the classifier side is set up equally or highly compared with the total pressure of an aerosol production range. With this composition, in order to receive

aerosol to a classifier, it is necessary to lower a static pressure by enlarging the carrier gas flow rate of the capture section.

Thereby, if the static pressure of the capture section can be lowered from the total pressure of an aerosol production range, aerosol can be transduced into the interior of a classifier with a 総圧としては同等かあるいは低 value equivalent or high as a total pressure from an aerosol production range equivalent or low

[0008]

[8000]

また、本発明のDMA型分級装 Moreover, the DMA type classifier of this



置は、分級装置側に構成された invention, 速が高まる構造となっている。 ゾル取り込み部の静圧をより効 side aerosol capture section. 果的に下げることを可能として いる。

aerosol capture the section エアロゾル取り込み部が、特定 constituted at the classifier side is having piping のキャリアガスが流れる配管構 structure where specific carrier gas flows, and 造をしており、かつ前後の配管 since it is set up more thinly than the diameter の径よりも細く設定されている of piping before and after, it has the structure ため、エアロゾル取り込み部に where the flow rate of the local carrier gas in the おける局所的キャリアガスの流 aerosol capture section increases.

Thereby, it makes it possible to lower more これにより、分級装置側エアロ effectively the static pressure of the classifier

[0009]

る構成をとっている。これによ り、さらに効果的に分級装置の エアロゾル取り込み部の静圧を 下げることになり、ひいてはよ り効率的にエアロゾルを分級装 内における媒質ガス(キャリア ガスもしくはシースガス)の質 a classification range. 量が重いことは、分級領域での 対象超微粒子のブラウン拡散を becomes goes up as a result. 抑制するので結果として分級精 度が上がることにもなる。

[0009]

さらに、本発明のDMA型分級 Furthermore, the DMA type classifier of this 装置は、エアロゾル発生領域に invention takes the composition into which the おける媒質ガス種と異なった種 medium gas of a different kind from the medium 類の媒質ガス、特にエアロゾル gas source in an aerosol production range and 発生領域における媒質ガス種よ medium gas with larger mass than the medium り質量の大きい媒質ガスが、分 gas source especially in an aerosol production 級装置内部のキャリアガスもし range are transduced as the carrier gas or くはシースガスとして導入され sheathing gas inside a classifier.

> This will further lower the static pressure of the aerosol capture section of a classifier effectively, as a result, aerosol can be more efficiently received to a classifier.

Simultaneously with it, that the mass of the 置に取り込むことができる。そ medium gas in a DMA type classifier (carrier れと同時に、DMA型分級装置 gas or sheathing gas) is heavy suppresses brown diffusion of the object ultrafine particle in

Therefore, a sharpness of classification also



[0010]

[0010]

【発明の実施の形態】

粒子分級方法において、エアロ ゾル発生領域の総圧に比較し アロゾル取り込み部の総圧が、 同等あるいは高く設定されてい り込み部にキャリアガスを大き より、取り込み部の静圧を下げ flow rate in the capture section. に、エアロゾルを導入すること が可能となる。

[0011]

[EMBODIMENT of the Invention]

本発明の請求項1に記載の発明 Invention of Claim 1 of this invention, in the は、エアロゾル発生領域からエ DMA microparticle classification method of the アロゾルを分級装置へ差圧を利 system which transduces aerosol from an 用して導入する方式のDMA微 aerosol production range to a classifier using pressure difference, compared with the total pressure of an aerosol production range, the て、分級装置側に構成されたエ total pressure of the aerosol capture section comprised at the classifier side is set up equally or highly.

る。この構成で、分級装置にエ With this composition, in order to receive アロゾルを取り込むために、取 aerosol to a classifier, the static pressure of the capture section is lowered by considering as the な流速で流す構造とすることに structure of passing carrier gas by the major

ている。これにより、取り込み If the static pressure of the capture section can 部の静圧をエアロゾル発生領域 be lowered from the total pressure of an aerosol の総圧より下げることができれ production range by this, aerosol can be ば、総圧としては同等かあるい transduced into the interior of the classifier は低いエアロゾル発生領域か which has a value equivalent or high as a total ら、総圧としては同等かあるい pressure from an aerosol production range は高い値をもつ分級装置内部 equivalent or low as a total pressure.

[0011]

ここで、請求項2に記載のよう Here like Claim 2, carrier gas with the specific に、分級手段側に構成されたエ aerosol capture section comprised at the アロゾル取り込み部が、特定の classification means side flows, and since the キャリアガスが流れるようにな diameter of an aerosol capture site is set up っており、かつエアロゾル取り more thinly than the diameter of piping before 込み部位の径は、その前後の配 and behind that, it has the structure where the 管の径よりも細く設定されてい flow rate of the local carrier gas in the aerosol



るため、エアロゾル取り込み部 capture section increases. る。これにより、分級装置側エ side aerosol capture section. アロゾル取り込み部の静圧をよ り効果的に下げることを可能と している。

における局所的キャリアガスの Thereby, it makes it possible to lower more 流速が高まる構造となってい effectively the static pressure of the classifier

[0012]

くはシースガスとして導入され Claim 3.4. 下げることなり、延いてはより efficiently received to a classifier. おける媒質ガス(キャリアガス 重いために、分級領域での対象 超微粒子のブラウン拡散による 果として分級精度が上がること にも繋がる。

[0012]

さらに、請求項3、4に記載の Furthermore, the medium gas of a different kind ように、エアロゾル発生領域に from the medium gas source in an aerosol おける媒質ガス種と異なった種 production range and medium gas with larger 類の媒質ガス、特にエアロゾル mass than the medium gas source especially in 発生領域における媒質ガス種よ an aerosol production range take the り質量の大きい媒質ガスが、分 composition transduced as the carrier gas or 級手段内部のキャリアガスもし sheathing gas inside classification means like

る構成をとっている。これによ This further lowers the static pressure of the り、さらに効果的に分級装置の aerosol capture section of a classifier エアロゾル取り込み部の静圧を effectively, as a result, aerosol can be more

効率的にエアロゾルを分級装置 Simultaneously, since the mass of the medium に取り込むことができる。同時 gas in a DMA microparticle classifier (carrier に、DMA微粒子分級装置内に gas or sheathing gas) is heavy, the spatial dissipation by brown diffusion of the object もしくはシースガス) の質量が ultrafine particle in a classification range is suppressed.

Therefore, it leads also to a sharpness of 空間的散逸を抑制するので、結 classification going up as a result.

[0013]

(実施の形態) 次に、本発明に (Embodiment) をする。図1に、本実施の形態 demonstrated.

[0013]

おける実施の形態について説明 Next, Embodiment in this invention is



類して、エアロゾル中の微粒子 を分級するエアロゾル分級部1 成部2により構成されている。 から構成されている。

[0014]

成室19とその真空排気系20 などから構成されている。エア evacuation group 20 etc. ロゾル生成部2は、微粒子を含 本体となる微粒子生成室19 と、微粒子生成室19に設けら れ微粒子生成室20内に設置さ れた固体ターゲット26に向け てパルスレーザビームを導入す る導入窓25と、固体ターゲッ ト26から放出されたエアロゾ ルをエアロゾル分級部2へ送給 する第1のエアロゾル搬送管2 8とから構成され、第1のエア ロゾル搬送管28の一端は微粒 子分級生成室19内の固体ター ゲット26設置部分まで延びて この先端にエアロゾルを収集す

における微粒子分級装置の断面 In FIG. 1, the cross-sectional model of the 模式図を示す。図1は大きく分 microparticle classifier in this Embodiment is shown.

FIG. 1 is roughly categorized, it comprises the と、微粒子を含むエアロゾルを aerosol classification section 1 which classifies 生成 (発生) するエアロゾル生 the microparticle in aerosol, and the aerosol generation section 2 which generates the さらに、エアロゾル分級部1は aerosol containing a microparticle (production). 2 重円筒微分形DMA微粒子分 Furthermore, the aerosol classification section 1 級装置本体3、エアロゾル取込 consists of double cylindrical differential type 部 5、エアロゾル搬送管 6 など DMA microparticle classifier main-body 3, aerosol taking-in section 5, and aerosol conveyance pipe 6 etc.

[0014]

エアロゾル生成部 2 は微粒子生 The aerosol generation section 2 consists of microparticle generation chamber 19, and its

The aerosol generation section 2 consists of a むエアロゾルを生成するための microparticle generation chamber 19 used as the main body for generating the aerosol containing a microparticle, an introductory window 25 which transduces a pulse-laser beam towards the solid target 26 which was prepared in the microparticle generation chamber 19 and installed in the microparticle generation chamber 20, and 1st aerosol conveyance pipe 28 which supplies the aerosol discharged from the solid target 26 to the aerosol classification section 2, the one end of 1st aerosol conveyance pipe 28 is prolonged to the solid target 26 installation part in the microparticle classification generation chamber 19, and the aerosol collection mouth 27 which るエアロゾル収集口27が設け collects aerosol is formed at this front end.

られている。微粒子生成室19 The turbo molecular pump 21 and the rotary



リーポンプ22とが接続されて 20. スフローコントローラ24が接 chamber 19. 続されている。

には、真空排気系20としてタ pump 22 are connected to the microparticle ーボ分子ポンプ 2 1 と、ロータ generation chamber 19 as evacuation -based

いる。また微粒子生成室19に Moreover, while the try pump 23 for drying the は、この微粒子生成室の内部を interior of this microparticle generation chamber 乾燥させるためのトライポンプ is connected, the mass-flow controller 24 is 2.3 が接続されるとともに、マ connected to the microparticle generation

[0015]

3とから構成されている。

[0015]

エアロゾル分級部1は大きく分 The aerosol classification section 1 comprises けて微粒子生成部 2 において生 an aerosol reception apparatus 30 which 成されたエアロゾルを取り込む receives the aerosol which roughly divided and エアロゾル取込み装置30と、 was generated in the microparticle generation 取り込まれたエアロゾルから微 section 2, and a microparticle classifier 3 which 粒子を分級する微粒子分級装置 classifies a microparticle from the received aerosol.

[0016]

エアロゾル取込み装置30は、 ロゾル搬送管6とから構成され 4.

[0016]

Aerosol reception apparatus 30, it consists of 上記第1のエアロゾル搬送管2 the aerosol taking-in section 5 which receives 8の他端に連結されエアロゾル the aerosol which was connected with the other 生成室19から送給されたエア end of said 1st aerosol conveyance pipe 28, ロゾルを取り込むエアロゾル取 and it supplied from the aerosol generation 込部 5 と、一端がエアロゾル取 chamber 19, carrier gas piping 4 for which the 込部 5 に接続されたキャリアガ one end was connected to the aerosol taking-in ス配管4と、キャリアガス配管 section 5, 2nd aerosol conveyance pipes 6 4とは反対側において一端がエ which turn to the microparticle classifier 3 the アロゾル取込部 5 に接続されエ aerosol which the one end was connected to アロゾル取込部5に取り込まれ the aerosol taking-in section 5 in the reverse たエアロゾルを微粒子分級装置 side, and was received by the aerosol taking-in 3へ向けて送給する第2のエア section 5, and supply it in the carrier gas piping

ている。このエアロゾル取込み As for this aerosol reception apparatus 30, as 装置30は図2に拡大して示す shown enlarging in FIG. 2, each part of the



ように、エアロゾル取込部5、 キャリアガス配管4、第2のエ アロゾル搬送管6の部分がいず り、キャリアガス配管4および エアロゾル搬送管6の直径に比 べてエアロゾル取込部5の直径 が小さな寸法に設定されてい る。また、キャリアガス配管4 の他端にはキャリアガス導入口 8が設けられ、このキャリアガ ス導入口8からはキャリアガス がエアロゾル取込部5の方へ向 けて送り込まれる。キャリアガ スはエアロゾル取込部5に取り 込まれたエアロゾルを微粒子分 級装置3へ向けて搬送する役割 を持つ。なお、エアロゾル取込 み装置30と微粒子分級装置3 との間にはエアロゾルをイオン 化するイオン化室7が設けられ ている。

ように、エアロゾル取込部 5 、 aerosol incorporation section 5, the carrier gas キャリアガス配管 4、第 2 のエ piping 4, and 2nd aerosol conveyance pipe 6 アロゾル搬送管 6 の部分がいず consists of tubular-shape objects, compared れも管状体から構成されてお with the diameter of the carrier gas piping 4 and り、キャリアガス配管 4 および the aerosol conveyance pipe 6, the diameter of エアロゾル搬送管 6 の直径に比 the aerosol taking-in section 5 is set as the ベてエアロゾル取込部 5 の直径 small dimension.

Moreover, the carrier gas inlet 8 is formed in the other end of the carrier gas piping 4, from this carrier gas inlet 8, carrier gas is fed towards the direction of the aerosol taking-in section 5.

Carrier gas has the role which turns to the microparticle classifier 3 the aerosol received by the aerosol taking-in section 5, and conveys it. In addition, the ionization chamber 7 which ionizes aerosol is formed between the aerosol reception apparatus 30 and the microparticle classifier 3.

[0017]

この実施の形態において、微粒子分級装置3にはDMA微粒子分級装置が採用されている。この微粒子分級装置3は、装置3は、装置6枚となる筒状の外殻円筒16の内部に配置された内殻円筒15と、先にで6とれた内殻円筒15と、搬送管6とれている。外殻円筒16は、基端部(後端部:右にでから構成されている。外殻円筒16は、基端部(後端部:右にでから構成されている。外殻に大力としたが方向を後にある。

[0017]

この実施の形態において、微粒 In this Embodiment, the DMA microparticle 子分級装置3にはDMA微粒子 classifier is adopted as the microparticle 分級装置が採用されている。こ classifier 3.

の微粒子分級装置 3 は、装置本 This microparticle classifier 3 consists of a 体となる筒状の外殻円筒 1 6 cylindrical outer-covering cylinder 16 used as と、外殻円筒 1 6 の内部に配置 an apparatus main body, an inner-husk cylinder された内殻円筒 1 5 と、先に述 15 arranged inside the outer-covering cylinder べた第 2 のエアロゾル搬送管 6 16, and 2nd aerosol conveyance pipe 6 とから構成されている。外殻円 described previously.

筒 1 6 は、基端部(後端部:エ The outer-covering cylinder 16 consists of the アロゾルの流れる方向先方を前 cylindrical body by which the base_end_part 方或いは先方とし、逆方向を後 (rear terminal part: make into the front or the



には外殻円筒16から段差状に 縮径したシースガス導入口9が 設けられている。また、外殻円 筒16の長手方向中間部の内部 には、当該外殻円筒16と内殻 円筒15との間に出来た隙間に より通路31が形成され、この 通路31の先方にはシースガス outer-covering cylinder 16. 取出口11が設けられている。 さらに、外殻円筒16の長手方 向中間部の側面の複数箇所に 連通する微細な隙間により成る 形成されている。

[0018]

内殻円筒15は外殻円筒16よ りも小さな径を持つ筒状体から 成り、その後端部は密閉される 一方、先端部は開放されたキャ ップ構造を有している。また、 内殻円筒15の先端寄り部分の 側面の複数箇所には、通路31 と内殻円筒15の内部とを連通 する微細な隙間により成るエア ロゾル取込スリット13が形成 されている。さらに、内殻円筒 15は、その先端部分において 上記エアロゾル取込スリット1 3部分から先方へ延びるエアロ

方とする) および先端部が開放 head the head of the direction where aerosol された筒状体から成り、基端部 flows, and let a reverse direction be back), and the leading end part were opened wide, the sheathing gas introduction port 9 which reduced in the shape of a step difference from the outer-covering cylinder 16 is formed in the base_end_part.

> Moreover, in the interior of the intermediate part longitudinal direction of the the

Path 31 is formed of the gap made between the outer-covering cylinder 16 and the inner-husk cylinder 15, sheathing gas output port 11 is は、当該外殻円筒 1 6 の内外を formed in the head of this path 31.

Furthermore, the aerosol ejection slit 12 which エアロゾル噴出スリット12が forms by the detailed gap which connects the inside and outside of the outer-covering cylinder 16 is formed in two or more places of the side face of the longitudinal-direction intermediate part of the outer-covering cylinder 16.

[0018]

The inner-husk cylinder 15 consists of the cylindrical body which is caused outer-covering cylindrical 16 and has a small path, while the rear terminal part is sealed, the leading end part has the cap structure opened wide.

Moreover, the aerosol taking-in slit 13 which forms by the detailed gap which connects path 31 and the interior of the inner-husk cylinder 15 is formed in two or more places of the side face of the front-end slippage part of the inner-husk cylinder 15.

Furthermore, the inner-husk cylinder 15 is connected to the aerosol extraction pipe 32 prolonged from the aerosol taking-in slit 13



ゾル取出管32に接続され、こ above-mentioned part to the other side in the のエアロゾル取出管 3 2 の先端 end part, the aerosol output port 10 from which には分級済のエアロゾルが取り 出されるエアロゾル取出口 1 0 formed at the front end of this aerosol extraction が形成されている。

[0019]

pipe 32.

[0019]

第2のエアロゾル搬送管6は、 外側から接続されている。

In microparticle classifier 3 part, 2nd aerosol 微粒子分級装置3部分において conveyance pipe 6 is branched and turns into は、分岐して複数(図 1 では 2 the branch pipes 6a and 6b of plurality (FIG. 1 つ) の分岐管 6 a 、6 b になり、 two), the front end of both the branch pipes 6a 両分岐管 6 a 、 6 b の先端は外 and 6b is connected to the aerosol ejection slit 殼円筒16の側面に形成された 12 formed in the side face of the outer-covering エアロゾル噴出スリット12に cylinder 16 from the outer side.

classification settled aerosol is taken out is

[0020]

(波長、パルス幅、エネルギー directions, etc. at this time. からの距離・方向などによって on particle size distribution.

[0020]

本実施の形態では、シリコン(S In this Embodiment, the ion * atom * cluster i) やゲルマニウム (Ge) な ablated from the surface of the solid target 26 ど高純度半導体の固体ターゲッ by carrying out condensing irradiation of the ト26に、パルスレーザビーム pulse-laser beam at the solid target 26 of を集光照射することで、固体タ high-purity semiconductors, such as silicone ーゲット26の表面からアブレ (Si) and germanium (Ge), (desorption * ート (脱離・射出) されたイオ emission) is atomized by making it re-condense ン・原子・クラスタを、ヘリウ in the physical gaseous phase impregnated with ム (He) などの希ガスが充満 noble gases, such as helium (He).

した物理的気相中で再凝縮させ The particle size distribution of the microparticle ることで微粒子化させる。この generated varies with a target material source, とき、生成される微粒子の粒径 the irradiation conditions (wavelength, a pulse 分布は、ターゲット材料種、パ width, energy density) of a pulse-laser beam, a ルスレーザビームの照射条件 rare gas pressure, distance from a target * the

密度)、希ガス圧力、ターゲット A rare gas pressure has most major influence

変化する。粒径分布に最も大き When Si is used as a semiconductor solid な影響を与えるのは、希ガス圧 material and He is used as a noble gas, the



20Torrで、粒径が数nm から数10nm、最大でも50 nmの、いわゆるナノ微粒子が 形成される。

力である。半導体固体材料とし several nm to 10 nm in a particle size, even てSi、希ガスとしてHeを用 maximum 50 nm so-called nano microparticle is いた場合、概ねガス圧が、3 - formed in general by 3-20 Torr a gas pressure.

[0021]

さらに具体的に本実施の形態に おけるナノ微粒子の生成方法に ついて述べる。微粒子生成室1 40%が表面露出原子となる) 感であることから、超高真空対 応に電界研磨を施されたSUS 304合金を用いて構成されて いる。接続される各バルブ・フ ランジも200℃ベークが可能 な超高真空対応品を使用してい る。この微粒子生成室19を、 ターボ分子ポンプ21を主ポン プ、ロータリーポンプ22をバ ッキングポンプとして排気する いる。ナノ微粒子生成時には、 マスフローコントローラ24を Heガス (純度99.999 9%以上) を200sccmの 一定流量で導入する。マスフロ ーコントローラ 2 4 及び高純度 mass-flow controller 24.

[0021]

The generation method of the nano microparticle in this Embodiment is further described concretely.

9は、表面露出原子数の大きい Since the large nano microparticle (about 40% ナノ微粒子(粒径5 n m では約 becomes a surface exposure atom in the particle size of 5 nm) of a surface exposure が酸化や不純物汚染に極めて敏 atomic number of the microparticle generation chamber 19 is very sensitive to oxidation or an impurity contamination, it is constituted by ultra-high-vacuum correspondence using the SUS304 alloy to which the electrical-field sanding was given.

> The elegance corresponding to a ultra-high vacuum to which 200-degree-C baking is made also as for each valve * flange connected is used.

This microparticle generation chamber 19, by ことにより、到達真空度として、 exhausting a main process pump and a rotary 10⁻¹⁰ Torr台を達成して pump 22 for a turbo-molecular pump 21 as a backing pump, the 10⁻¹⁰ Torr base is attained as an attainment degree of vacuum.

介して高純度半導体プロセス用 At the time of nano microparticle generation, He gas for high-purity semiconductor processes (purity of 99.9999 % or more) is introduced with the constant flow of 200 sccm through the

半導体プロセス用Heガス導入 The mass-flow controller 24 and He gas



配管系はEPグレードの高純度 transduction 対応品を使用している。この場 semiconductor processes はなく、ドライポンプ23によ grade. r r を保っている。

pipe line for high-purity are using the 合は、ターボ分子ポンプ21で elegance corresponding to a high purity of EP

り差動排気することにより、 — In this case, fixed He atmosphere pressure 10.0 定のHe雰囲気圧10. 0To Torr is maintained the differential exhaust not with the turbo molecular pump 21 but with the dry pump 23.

[0022]

[0022]

て、微粒子生成室19に設置さ ムを石英製のレーザ光導入窓2 においてアブレーションを起こ made from quartz. 10Ω·cm)を使用した。パル was used. Gレーザの第2高調波(波長: 532 n m、パルスエネルギ pulse-energy:10mJ, 表面上で10 I/c m² のエネ solid target 26. ルギー密度になるよう集光照射 している。

上述の減圧He雰囲気におい In the above-mentioned pressure-reduction He atmosphere, it installs in the microparticle れ、8 r p m (回転/分) の角 generation chamber 19, at the solid target 26 速度で自転している固体ターゲ which autorotates with the angular velocity of 8 ット26に、パルスレーザビー rpm (rev/min.), an ablation is caused in the surface of the solid target 26 by carrying out 5を通して集光照射すること condensing irradiation of the pulse-laser beam で、固体ターゲット26の表面 through the laser-beam transduction window 25

す。ここで、固体ターゲット2 Here, as a solid target 26, the high-purity Si 6としては高純度 Si 単結晶基 single-crystal base plate (surface-orientation 板(面方位(100)、比抵抗 (100), specific-resistance 10(OMEGA) *cm)

スレーザビームの集光照射とし As condensing irradiation of a pulse-laser ては、QースイッチNd:YA beam, condensing irradiation of the 2nd harmonic (wavelength: 532 pulse-width:40ns, ー:10mJ、パルス幅:40 repeating frequency:10Hz) of Q-switch Nd:YAG ns、繰り返し周波数:10H laser is carried out so that it may become z) を、固体ターゲット26の 10J/cm² energy density on the surface of the

[0023]

[0023]

固体ターゲット26の表面から Si source (ion * atom * cluster) which it ablated



どうしの会合が促進されること わちナノ微粒子生成が起こる。 距離・方向、雰囲気希ガス圧力 etc. などによって変化する。

[0024]

はなされにくくなり、射出Si Si薄膜として凝縮するように なる。この閾値は、材料として plate. SiとHeを用い、レーザとし てパルス幅が数から数十nsの vicinity 合、3-5Torr付近にある。 また、雰囲気希ガス圧力がこの using Si and He as a material. 閾値を超えて高くなり過ぎる 急激に発生し出し、見かけ上2 Onm以上の微粒子が生成され threshold-value,

アブレート (脱離・射出) され from the surface of the solid target 26 たSi種(イオン・原子・クラ (desorption * emission) dissipating the original スタ)は、雰囲気Heの原子と emission kinetic energy to atmosphere He gas 衝突を繰り返すことにより当初 by repeating the impact with the atom of の射出運動エネルギーを雰囲気 Atmosphere He, it is that association of Si He ガスへ散逸しつつ、Si種 sources is promoted and takes place, the condensation, i.e., the nano microparticle で、物理的気相中での凝縮すな generation, in a physical gaseous phase.

At this time, the particle size distribution of the このとき、生成されるナノ微粒 nano microparticle generated varies with a 子の粒径分布は、ターゲット材 target material source, the irradiation conditions 料種、パルスレーザビームの照 (wavelength, a pulse width, energy density) of a 射条件(波長、パルス幅、エネ pulse-laser beam, distance from a target * the ルギー密度)、ターゲットからの direction and atmosphere noble-gas pressure,

[0024]

粒径分布に最も大きな影響を与 An atmosphere noble-gas pressure has most えるのは雰囲気希ガス圧力であ major influence on particle size distribution.

る。これがある閾値を下回ると If less than a threshold-value with this, the nano 急激に気相でのナノ微粒子生成 microparticle generation by the gaseous phase will no longer be made rapidly, it comes to 種の大半は堆積基板上で非晶質 condense most emission Si sources as an amorphous Si thin film on the deposition base

This threshold-value is in 3 to 5 Torr in the

Qースイッチレーザを用いた場 In the case using the Q switched laser of several to several 10ns pulse width as a laser,

と、ナノ微粒子どうしの凝集が Moreover, if an atmosphere noble-gas pressure becomes higher too much exceeding this aggregation たり、さらにこれらがブドウの microparticles will begin to produce rapidly,



けられるようになる。これは、 射出Si種の雰囲気希ガスによ る閉じ込め効果(プルームの閉 じ込め効果)が顕著になること り過ぎるためである。

房状に凝集したものが多数見受 apparant 20 nm or more of a microparticle is generated.

> Many things which these aggregated in the shape of grape fringe can further see now.

This is for the space density of an emission Si で射出Si種の空間密度が上が source to go up by the lock-in effect (the lock-in effect of a plume) by the atmosphere noble gas of an emission Si source becoming remarkable too much.

[0025]

した。また、固体ターゲット2 6表面からの距離が長くなるに つれても微粒子の成長が促進さ れる傾向がある。したがって、 本実施の形態では、固体ターゲ ット26表面の鉛直上3.0 cm にエアロゾル収集口27を 設け、気相で生成したナノ微粒 子を雰囲気Heガスとともにエ より、運動エネルギーを散逸さ せて気相に滞留することで不要 な凝集による大粒化を抑制して いる。ここで収集されたSiナ ノ微粒子を含有しHeガスを媒 アロゾル搬送管28を通って、 ル取込部5に流入する。

[0025]

そこで、本実施の形態では、ナ So, in this Embodiment, 10.0 Torr was set up as ノ微粒子生成が起こる上でなる atmosphere He pressure low as possible when べく低い雰囲気He 圧力とし nano microparticle generation takes place.

て、10.0 Torrを設定 Moreover, even if the distance from the solid target 26 surface takes for getting long, there is an inclination for the growth of a microparticle to be promoted.

> Therefore, in this Embodiment, the aerosol collection mouth 27 is formed in 3.0 cm on the perpendicularity of the solid target 26 surface, and the nano microparticle generated by the gaseous phase is drawn out as aerosol with atmosphere He gas.

アロゾルとして引き出すことに Large drop-ization by unnecessary aggregation is suppressed by making a kinetic energy dissipate and piling up in a gaseous phase by that cause.

The aerosol which contains microparticle collected here and makes He gas 質ガスとするエアロゾルは、エ medium gas passes along the aerosol conveyance pipe 28, and flows in it in the エアロゾル分級部1のエアロゾ aerosol taking-in section 5 of the aerosol classification section 1.

[0026]

[0026]



部2の総圧に比較して、エアロ ゾル分級部1側に構成されたエ アロゾル取込部5の総圧が、同 等あるいは高く設定されてい る。この構成で、DMA微粒子 分級装置3にエアロゾルを取り 込むために、エアロゾル取込部 5にキャリアガスを大きな流速 で流す構造とすることにより、 げている。これにより、エアロ ゾル取込部5の静圧をエアロゾ ル発生領域の総圧より下げるこ とができれば総圧としては同等 かあるいは低いエアロゾル発生 領域から、総圧としては同等か あるいは高い値をもつDMA微 粒子分級装置3内部に、エアロ ゾルを導入することが可能とな る。

本実施の形態のDMA微粒子分 In the DMA microparticle classifier 3 of this 級装置3では、エアロゾル生成 Embodiment, the total pressure of the aerosol taking-in section 5 constituted at the aerosol classification section 1 side is set up equally or highly compared with the total pressure of the aerosol generation section 2.

With this composition, in order to receive aerosol to the DMA microparticle classifier 3, the static pressure of the aerosol taking-in section 5 is lowered by considering as the structure of passing carrier gas by the major エアロゾル取込部 5 の静圧を下 flow rate in the aerosol taking-in section 5.

> Thereby, if the static pressure of the aerosol taking-in section 5 can be lowered than the total pressure of an aerosol production range, as a total pressure, aerosol can be introduced into the DMA microparticle classifier 3 interior which is equivalent or has a high value from an aerosol production range equivalent or low as a total pressure.

[0027]

微粒子とHe媒質ガスからなる 級部1のエアロゾル取込部5に 用いて若干詳しく説明する。

[0028]

送管28を通って、エアロゾル aerosol

[0027]

上述の構成によって、Siナノ Above-mentioned composition demonstrates a little the mechanism in which the aerosol which エアロゾルが、エアロゾル搬送 is made of a Si nano microparticle and He 管28を通って、エアロゾル分 medium gas passes along the aerosol conveyance pipe 28, and flows in the aerosol 流入する機構を、エアロゾル取 taking-in section 5 of the aerosol classification 込部 5 周辺の拡大図(図 2)を section 1, in detail using the expanded view (FIG. 2) of aerosol taking-in section 5 periphery.

[0028]

対象エアロゾルがエアロゾル搬 In order to design conditions so that object may aerosol pass along the



するためには、総圧(popとす る) なる微粒子生成室19及び エアロゾル搬送管28から、静 圧 (pt とする) なるエアロゾル 取込部5への流入状況を流体力 学的に解析する必要がある。図 2に示すように、微粒子生成室 19の内部における実質的流速 は無視でき、エアロゾル取込部 5 内部では、流速 (qt とする) の層流があるとしている。ここ る関係が成り立っている。

【数1】

$$P + \frac{\rho q^2}{2} = P.$$

 $\cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

[0029]

運動論的解析を加味することに By

分級部 1 のエアロゾル取込部 5 conveyance pipe 28 and may be introduced into に導入されるよう緒条件を設計 the aerosol taking-in section 5 of the aerosol classification section 1, it is necessary to analyze hydrodynamically the inflow situation from the microparticle generation chamber 19 made into total-pressure (pop, and the aerosol conveyance pipe 28 to the aerosol taking-in section 5 made into static-pressure (pt.

> As shown in FIG. 2, the essential flow rate in the interior of the microparticle generation chamber 19 can be disregarded, and supposes that there is a laminar flow made into flow-rate (qt in the aerosol taking-in section 5 interior.

で一般に、媒質の静圧 p、総圧 Generally between the static pressure p of a p_o 、密度 ρ 、流速 q の間には medium, total-pressure p_o , a density (rho), and 流体力学のベルヌーイの定理か the flow velocity q, the relationship expressed ら、次の第(1)式で表わされ with the following first formula consists of the theorem of Bernoulli of hydrodynamics here.

[EQUATION 1]

****(1).

[0029]

以降、添え字「p」が微粒子生成 Henceforth, a subscript "p" shall show the 室19の内部を、添え字「t」が interior of the microparticle generation chamber エアロゾル取込部 5 の内部を示 19, and a subscript "t" shall show the interior of すものとする。これに気体分子 the aerosol taking-in section 5.

seasoning this with а より、エアロゾル搬送管28か kinetic-theory-of-gases-analysis, a square of



式で表現することができる。

らエアロゾル取込部5への流入 inflow speed qp from the aerosol conveyance 速度 g p の 2 乗を、次の第(2) pipe 28 to the aerosol taking-in section 5 can be expressed by the following second formula.

【数2】

[EQUATION 2]

$$q_{p}^{2} = \frac{2 \gamma}{\gamma - 1} \frac{P_{op}}{P_{p}} \left\{ 1 - \left(\frac{P_{oi} - \frac{P_{i} q_{i}^{2}}{2}}{P_{op}} \right)^{(p-1)/p} \right\}$$

$$\cdot \cdot \cdot (2)$$

****(2).

[0030]

ものである。Ar(アルゴン) 体)では、気体の種類によらず 1667である。本実施の形態 では、キャリアガスとして、総 圧25TorrのArを、微粒 子生成室19側のエアロゾル媒 質ガスとして、総圧10Tor rのHeを採用している。この 込部5での流速 q, が、260 m 速 g t には上限があって、その値 The value is 336 m/s. は336m/sである。また、

[0030]

ここで γ は媒質ガスの比熱比で (gamma) is decided by the ratio of specific beat 気体分子の構造によって決まる of medium gas according to the structure of a gas molecule here.

やHeなどの希ガス (単原子気 In noble gases (monoatomic gas), such as Ar (argon) and He, it is not based on a gaseous kind but is 1667.

> In this Embodiment, Ar of 25 Torr of total pressures is adopted as carrier gas, as aerosol medium gas by the side of the microparticle generation chamber 19. He of 10 Torr of total pressures is adopted.

設定においては、エアロゾル取 In this setup, if flow-rate qt in the aerosol taking-in section 5 reaches 260 m/s, the inflow / s に到達すると、エアロゾル to the aerosol taking-in section 5 from the 搬送管28からエアロゾル取込 aerosol conveyance pipe 28 can be performed. 部5への流入が可能となる。ま Moreover, there is an upper limit in flow-rate q た、エアロゾル取込部 5 での流 in the aerosol taking-in section 5.

Moreover, there is an upper limit also in inflow



pにも上限があって、その値は The value is 1680 m/s. り決まるもので、正しく音速で It is acoustic velocity surely. ある。

エアロゾル搬送管 2 8 からエア flow-rate qp from the aerosol conveyance pipe ロゾル取込部 5 への流入流速 q 28 to the aerosol taking-in section 5.

1680m/sである。なお上 In addition, the flow-rate upper limit of said 2 記2種類の流速上限値は圧力設 kind is not based on a pressure setup, but is 定にはよらず、気体種類(分子 decided only by the gas kind (molecular weight, 量、分子構造)と温度のみによ molecular structure) and temperature.

[0031]

の他の各設定パラメータ: ρ_t , $(rho)_t$, p_{ot} , $(rho)_p$, and p_{op} pに及ぼす効果を導くことがで can be drawn. とめておく。

[0031]

さらに、(数2) から特に、エア Furthermore, other each setting parameter it is ロゾル取込部 5 での流速 q t を proved that it is that pt falls and the capture of 上げることにより pt が下がり、 aerosol can be effectively promoted by raising 効果的にエアロゾルの取り込み flow-velocity q_t in the aerosol taking-in section を促進できることが判明するそ 5 in particular from (Equation 2):

 p_{ot} , ρ_p , p_{op} が、流入流速 q The effect exerted on inflow flow-velocity q_p

きる。その結果を(表 1)にま The result is summarized in (Table 1).

【表1】

[TABLE 1]

キャリアガス流速 q _i	q _i ²
キャリアガス密度 ρ,	$\rho_{\mathfrak{t}}$
キャリアガス総圧 pa	-pa
エアロゾル媒質ガス密度 ρ,	$\rho_{\mathfrak{p}}^{-1}$
エアロソル媒質ガス総圧 pop	Pop

The carrier gas flow velocity Carrier gas density Carrier gas total pressure



Aerosol medium gas density Aerosol medium gas total pressure

[0032]

スArの流量を2.0 1/mi n (標準状態) と設定している。 condition). いほど有利であるが、後述する mentioned above. ように、あまり上げてしまうと However, まうからである。エアロゾル取 that it may mention later. 込部5において、この流量(2. 達成するよう設定すると、エア mmとすべきことが導かれる。 キャリアガス配管4としては、 し易さと、配管全体のコンダク タンス確保の必要性から、内径 4. 3 mmの1/4インチ配管 を使用しているため、エアロゾ ル取込部5では図2に示すよう にくびれ構造をとっている。こ こで、エアロゾル取込部5での キャリアガス流速qtを上限速 度336m/sの80%と設定 すると、エアロゾル搬送管28 からエアロゾル取込部5への境 界領域での流入流速g。は、3 38m/sとなり実用上充分な 値が確保される。

[0032]

本実施の形態では、キャリアガ In this Embodiment, the rate of flow of carrier gas Ar is set up with 2.0 l/min (standard

エアロゾルの取り込みにおいて In the capture of aerosol, it is so advantageous は、前述のようにこの流量が多 that there are many these rate of flows as

it classification is because シースガスとの比率が上がるこ degradation ability will fall because a ratio with とで、分級分解能が低下してし sheathing gas increases if it raises not much so

In the aerosol taking-in section 5, if it sets up so 0 I/m i n)を先の流速 q t 上 that this rate of flow (2.0 I/min) may be attained 限速度336m/sの80%で at 80% with a previous flow-velocity qt upper limit speed of 336 m/s, what the diameter of the ロゾル取込部 5 の径は、2.5 aerosol taking-in section 5 should consider as 2.5 mm will be drawn.

As carrier gas piping 4, since 1 / 4 inch piping of クリーン度が高いEP管の入手 internal diameter 4.3 mm are used from the ease of acquiring of EP pipe with the high degree of cleanness, and the necessity for conductance ensuring of the whole piping, as shown in FIG. 2 in the aerosol taking-in section 5, necking structure has been taken.

> Here, if carrier gas flow-velocity qt in the aerosol taking-in section 5 is set up with 80 % with an upper limit speed of 336 m/s, inflow flow-velocity q_p in the limit range from the aerosol conveyance pipe 28 to the aerosol taking-in section 5 will become 338 m/s, and it will ensure practically sufficient value.



[0033]

上述の機構で、エアロゾル分級 部1のうちエアロゾル取込部5 に導入されたエアロゾルは、生 成当初はSiナノ微粒子とHe が、キャリアガス導入口8から 導入されるキャリアガスである アルゴン (Ar) と混合される ため、媒質ガスがAr+ Heの 混合ガスであるエアロゾルとな って、DMA微粒子分級装置本 体3に向かって搬送され始め る。次に、イオン化室7を通過 する際に内部に設置された放射 性同位体アメリシウム (²⁴¹ A m) の発する放射線により、S iナノ微粒子が荷電する。この 時の荷電率は、ナノ微粒子の粒 径とエアロゾル搬送管6内部の 圧力(主に総圧)に依存するが、 本実施の形態では粒径 5 n mの conveyance pipe 6 interior. Siナノ微粒子に対して、約1 0⁻⁵ の率で1 価に荷電すること orrを想定)。

[0034]

Aの形式である。これは同心状 DMA.

[0033]

The aerosol transduced into the aerosol taking-in section 5 among the aerosol classification sections 1 by the above-mentioned mechanism consisted of a Si 媒質ガスから構成されていた nano microparticle and He medium gas at the beginning of generation.

> However, since it mixes with the argon (Ar) which is carrier gas introduced from the carrier gas inlet 8, medium gas becomes aerosol which is the mixed gas of Ar+He, and begins to be conveyed toward DMA microparticle classifier main-body 3.

> Next, Si nano microparticle electrically charges according to the radiation which radioisotope americium (241Am) installed in the interior emits when passing an ionization chamber 7.

> The charge rate at this time is dependent on the particle size of a nano microparticle, and the pressure (mainly total pressure) of the aerosol

However, in this Embodiment, it can electrically charge monovalent by approximately 10⁻⁵ rate ができる(圧力10-100 T to Si nano microparticle with a particle size of 5 nm (pressure 10-100 Torr was assumed).

[0034]

エアロゾル搬送管 6 はDMA微 Before flowing in the aerosol conveyance pipe 6 粒子分級装置本体 3 に流入する to DMA microparticle classifier main-body 3, it is 前に、対称な形で2系統に分岐 branched to two lines in a symmetrical form.

される。DMA微粒子分級装置 DMA microparticle classifier main-body 3 is the 本体3は、2重円筒微分形DM mode of double cylindrical differential type

に配置された内殻円筒 1.5 と外 This is constituted on the basis of the

(C) DERWENT



殻円筒16を基本に構成されて inner-husk cylinder 15 and the outer-covering いる。2系統に分岐されたエア cylinder 16 which have been arranged in the ロゾル搬送管6は、2重円筒構 3に接続されている。その他に、 DMA微粒子分級装置本体3に は、シースガス導入口9、分級 出口11は、エアロゾル搬送管 6と同様に、2重円筒構造の共 main-body 3. れている。

shape of concentric. 造の共通中心軸に対称な形状 The aerosol conveyance pipe 6 which branched で、DMA微粒子分級装置本体 to two lines is a shape symmetrical to the common center axis of double cylindrical

structure, and is connected to DMA microparticle classifier main-body 3. 済みエアロゾル取出口10、シ In addition, the sheathing gas introduction port ースガス取出口11が接続され 9, classification completed aerosol output port ている。ここで、シースガス取 10, and sheathing gas output port 11 are

connected to DMA microparticle classifier

通中心軸に対称な形状で接続さ Here, sheathing gas output port 11 is connected in the shape symmetrical to the common center axis of double cylindrical structure like the aerosol conveyance pipe 6.

[0035]

本体3の動作の概略を説明す る。先ず、シースガス導入口9 導入される。このシースArガ gas introduction port 9. スは、フィルターメッシュ14 を介して、外殻円筒16と内殻 円筒15との空間(ここが狭義 入することで、分級領域29で and the inner-husk cylinder 15. きる。流入するシースArガス a laminar flow effectively.

[0035]

ここで、DMA微粒子分級装置 Here, the outline of an operation of DMA classifier main-body microparticle 3 demonstrated.

より、シースガスとしてArガ First, Ar gas is transduced by the rate of flow of スが、20 l/m i nの流量で 20 l/min as sheathing gas from the sheathing

This sheathing Ar gas, the filter mesh 14 is intervened and it flows in to the space (thbecomess the classification region 29 in a での分級領域29になる)に流 narrow sense) of the outer-covering cylinder 16

は効果的に層流となることがで Then in the classification region 29, it becomes

にほぼ等しい流量が、シースガ A rate of flow almost equivalent to the sheathing ス取出口11から大型メカニカ Ar gas which flows in is discharged with the ルブースターポンプが接続され rotary pump to which the large-sized たロータリーポンプにより排出 mechanical boster pump was connected from



される。一方、媒質ガスは、A sheathing gas output port 11. 入される。

[0036]

分級領域29では、内殻円筒1 高電圧電極17と、外殻円筒1 放射状の静電界を印加されてい る。エアロゾル噴出スリット1 粒子は、層流状のシースガスの る。イオン化室7にて荷電され sheathing gas output port 11. たSiナノ微粒子は分級領域2 9に形成された静電界により偏 向する。特に負に荷電されたS i ナノ微粒子は、内殻円筒 1 5 0から取り出すことができる。

r + Heの混合ガスから成っ On the other hand, medium gas consists of the ており、Siナノ微粒子を含有 mixed gas of Ar+He, from the aerosol するエアロゾルはDMA微粒子 conveyance pipe 6 which branched in the 分級装置本体3の2重円筒構造 shape symmetrical to the common center axis の共通中心軸に対称な形状に分 of the double cylindrical structure of DMA 岐した、エアロゾル搬送管 6 か microparticle classifier main-body 3, the aerosol ら、エアロゾル噴出スリット1 which contains Si nano microparticle passes 2を通って、分級領域29に導 along the aerosol ejection slit 12, and is transduced into the classification range 29.

[0036]

In the classification region 29, the electrostatic 5の外壁に貼りつけられた正極 field radial on a common centre axis is impressed by the positive-plate high-voltage 6の内壁に貼りつけられた接地 electrode 17 stuck on the outer wall of the 電極18により、共通中心軸に inner-husk cylinder 15, and the earth electrode 18 stuck on the inner wall of the outer-shell cylinder 16.

2から分級領域29に導入され Si nano microparticle which was transduced た荷電されていないSiナノ微 into the classification range 29 from the aerosol ejection slit 12 and which it does not electrically 流れに乗って、エアロゾル噴出 charge rides the flow of laminar flow-like スリット12からシースガス取 sheathing gas, and is conveyed from the 出口11の方向(図1の中では aerosol ejection slit 12 in the direction of 左から右)に搬送され、シース sheathing gas output port 11 (from the left to the ガス取出口11から排出され right [The inside of FIG. 1]), it discharges from

> Si nano microparticle which it electrically charged by the ionization chamber 7 is deflected by the electrostatic field formed in the classification range 29.

の側に引き寄せられ、一部はエ Si nano microparticle which especially negative アロゾル取込スリット13を経 electrically charged can be drawn near to the て、分級済エアロゾル取出口1 inner-husk cylinder 15 side, one part can be taken out from classification settled aerosol



output port 10 passing through the aerosol taking-in slit 13.

[0037]

分級領域29での荷電微粒子の 軌跡は、原理的には、荷電微粒 子のシースガス中での移動度、 度、静電界強度分布、幾何学形 状(分級長L、内殼円筒径R₁、 タとして、シースガスの種類・ 数などが軌跡を決定している。 定することにより、特定の粒径 determine the tracing. きる。すなわち分級を行うこと が可能となる。通常は、横方向 output port 10. て) を調整することで、ある範 after classification, 囲では任意の分級後粒径を選ぶ electrostatic-field ことができる。

[0038]

[0037]

Theoretically, the tracing of the charge fine particle in the classification region 29 is decided by the mobility in the inside of the sheath gas of シースガスによる横方向搬送速 a charge fine particle, the lateral-direction conveyance velocity bγ sheath gas, electrostatic-field intensity distribution, the 外殼円筒径R₂)などにより決 geometrical shape (classification length L, 定される。実際の動作パラメー diameter of an inner-husk cylinder R1, and diameter of an outer-shell cylinder R₂), etc. 流量、荷電微粒子の大きさ・価 As an actual parameter of operation, the kind * rate of flow of sheathing gas, the size * valence これらのパラメータを適切に設 of an electric-charge microparticle,

の微粒子を分級済工アロゾル取 By setting up these parameters appropriately, 出口10から抽出することがで the microparticle of a specific particle size can be extracted from classification settled aerosol

搬送速度と幾何学形状の設定に That is, a classification can be performed.

より、分級後粒径の中心値を決 Usually, in a certain range, the desired particle 定しておき、最後に静電界強度 sizes after classification can be chosen by (ソフト的なパラメータとし determining the central value of the particle size and finally adjusting setup strength bv lateral-direction conveyance speed and a geometrical shape, (as a parameter like a soft).

[0038]

現実には、この際の分級精度が、 Actually, the sharpness of classification in this 有限のスリット幅、シースガス case will have limited particle-size-distribution 中におけるナノ微粒子のブラウ width also even for after classification under the ン拡散の影響により、分級後も influence of brown diffusion of the nano 有限の粒径分布幅を持つことに microparticle in a limited slit width and



なる。本実施の形態では、分級 sheathing gas. 可変とし、-1価に荷電したS 1.2を実現している。

[0039]

1 3 倍の粘性率 μ を持つため、 上させることができるからであ this (micron) as He. り、分級分解能を極めて有効に viscosity micron of sheath gas. 析することにより得られた、分 double

領域幾何学形状として、L:2 In this Embodiment, as a classification region 0 mm, R_1 : 2.5 mm, R_2 : geometrical shape, I:20 mm and R_1 : 35 mm 、シースガスとして、 mm and R₂: 35 mm, as sheath gas, Ar gas is Arガスを20 I/m i n、印 made into 20 l/min and an applied voltage is 加電圧を1-200Vの範囲で made as variable in 1-200V, making into object Si nano fine particle which electrically charged i ナノ微粒子を対象とすること to -1 value|valence can determine a で、粒径中心値を5-10nm particle-size central value as desired in the の範囲で任意に決定でき、分級 range of 5-10 nm, it implements that the 後の粒径分布幾何標準偏差が particle-size-distribution geometry standard deviation after classification is 1.2.

[0039]

ここで、シースガスとしてAr Here, Ar gas is used as sheath gas because the ガスを用いるのは、He O 1. resolving power of a classification can be 6 8 倍の分子径 σ、同じく 1. improved also by the same rate of flow, since it has a 1.68 times as many molecular diameter 同じ流量でも分級の分解能を向 (sigma) as He and 1.13 times the viscosity of

る。しかも、希ガスの中では最 And in a noble gas, it is the cheapest.

も安価である。2重円筒微分形 In a double cylindrical differential type DMA DMA分級装置においては、シ classifier, classification degradation ability can ースガスの分子径σ及び粘性率 be improved very effectively by setting up μを大きく設定することによ greatly the molecular diameter (sigma) and

向上させることができる。これ The relation of the following third formula は、2 重円筒微分形DMA微粒 expressing a square of the relative full width at 子分級装置の分級領域における half maximum FWHM of the particle size エアロゾル (微粒子と媒質ガ distribution after classification obtained by ス:キャリアガスとシースガス) analyzing the behavior of the aerosol (a の挙動を、気体分子運動論に基 microparticle and medium gas: carrier gas and づくブラウン拡散現象として解 sheathing gas) in the classification range of a cylindrical differential type 級後における粒径分布の相対半 microparticle classifier as a brown diffusion 値全幅FWHMの2乗を表現す phenomenon based on a kinetic theory of gases



る次の第(3)式の関係式で説 can demonstrate this. 明することができる。

【数3】

[EQUATION 3]

$$FWHM^{2} = const. \times \frac{\left(b + \frac{1}{b}\right) \frac{R_{1}}{R_{2}} (R_{1} + R_{2}) (kT)^{2}}{\mu \cdot \sigma^{2} \cdot Q \cdot P \cdot d_{p}^{2}}$$

$$b = \frac{L}{R_{2} - R_{1}}, const. \approx 2.784$$

****(3).

[0040]

スガス流量Q、分級動作圧力 p 、 operation parameters, く。k はボルツマン定数である。 micron can be drawn.

[0040]

分級分解能が相対半値全幅 Classification degradation ability presupposes FWHM の逆数に比例するもの that it is a thing proportional to the inverse of the であるとし、第(3)式を活用 relative full width at half maximum FWHM, by することで、シースガスの分子 using formula (3), the dependence to the 径 σ、粘性率 μ の他にも、シー classification degradation ability of classification such as sheath 分級動作温度Tなどの分級動作 gas-flow-rate Q, the classification working パラメータの、分級分解能への pressure p, and the classification operating 依存性を導くことができる。こ temperature T, other than the molecular の結果を(表2)にまとめてお diameter (sigma) of sheath gas and a viscosity

> This result is summarized in (Table 2). K is a Boltzmann's constant.

【表2】

[TABLE 2]



シースガス流量 Q	Q 0.5
動作圧力 p	pos
シースガス分子径 σ	σ
微粒子の粒径 🖟	$d_{\mathfrak{p}}$
動作温度 T	T-1

Sheath gas flow rate Working pressure The diameter of a sheath gas molecule The particle size of a fine particle Operating temperature

[0041]

本実施の形態では、Siナノ微 In this Embodiment によって、分級分解能を向上さ taking a large molecular diameter (sigma). せる意図がある。また、シース Moreover, you also ガス流量Qもできるだけ大きく させている。分級動作圧力 p は、 Siナノ微粒子生成時のHeガ ス圧力が低いため(10.0T orr) むやみには高くできな い。すなわち、エアロゾル取込 部5の機構に制限される。 さら に、動作温度であるが、これを section 5 limits. 温動作としている。最後に、対 apparatus actually.

[0041]

粒子生成時に必要な軽いHeガ Apart from light He gas required at the time of Si スとは別に、シースガスとして nano fine-particle generation, using Ar gas は重いArガスを用いているの heavy as sheath gas has the intent made to は、分子径σを大きくとること improve classification degradation ability by

set up sheathing gas-flow-rate Q as greatly as possible, and it is 設定して分級分解能向上に寄与 making it contribute to a classification resolution enhancement.

> Since He gas pressure at the time of Si nano fine-particle generation is low (10.0 Torr), the classification working pressure p is not made highly recklessly.

> That is, the mechanism of the aerosol taking-in

低く設定することが分級分解能 Furthermore, it is an operating temperature.

向上に有効ではあるが、現実的 However, it is effective in a classification に装置全体を冷却することには resolution enhancement to set this up low.

大きなコストがかかるので、室 However, major cost starts cooling the whole



象微粒子の粒径dpであるが、 これが小さくなるにつれて分級 room-temperature operation. 分解能が低下する傾向にある。 数nm、特に5nm以下のナノ 微粒子を対象とするDMA分級 装置の設計には細心の注意が必 要とされる。

Therefore, it is considering the

Finally, it is particle-size d_p of an object microparticle.

However, it is in the trend for classification degradation ability to fall as thbecomess smaller.

A careful caution is needed for design of the DMA classifier which makes object a several nm, in particular 5 nm or less nano fine particle.

[0042]

[0042]

【発明の効果】

エアロゾル発生領域からこれを おいて、総圧としては同等かあ るいは低いエアロゾル発生領域 から、総圧としては同等かある いは高い値をもつ分級装置内部 に、エアロゾルを導入・分級す total pressure. ることが可能となる。ここで、 分級装置側に構成されたエアロ ゾル取り込み部が、特定のキャ ており、かつ前後の配管の径よ after. 静圧をより効果的に下げること side aerosol capture section. を可能としている。

[ADVANTAGE of the Invention]

以上のように、本発明によれば、 As mentioned above, according to this invention, in the DMA type classifier of the 分級装置へ差圧を利用して導入 system which introduces this from the aerosol する方式のDMA型分級装置に production region to a classifier using pressure difference, aerosol can be introduced * classified inside the classifier which has a value equivalent or high as a total pressure from the aerosol production region equivalent or low as a

Here, the aerosol capture section comprised at the classifier side is having piping structure where specific carrier gas flows, and it set up リアガスが流れる配管構造をし more thinly than the path of piping before and

りも細く設定したことで、分級 Thereby, it makes it possible to lower more 装置側エアロゾル取り込み部の effectively the static pressure of the classifier

[0043]

[0043]

また、エアロゾル発生領域にお Moreover, the medium gas of a different kind



の媒質ガス、特にエアロゾル発 生領域における媒質ガス種より 装置内部のキャリアガスもしく はシースガスとして導入される 的に分級装置のエアロゾル取り 込み部の静圧を下げることな り、ひいてはより効率的にエア ロゾルを分級装置に取り込むこ とができる。同時に、DMA型 分級装置内における媒質ガス (キャリアガスもしくはシース ガス) の質量が大きいために、 分級領域での対象超微粒子のブ ラウン拡散による空間的散逸を 抑制するので、結果として分級 精度を上げることも可能として いる。

ける媒質ガス種と異なった種類 from the medium gas source in the aerosol production region and medium gas with larger mass than the medium gas source in particular 質量の大きい媒質ガスが、分級 in the aerosol production region will further lower the static pressure of the aerosol capture section of a classifier effectively by having taken 構成をとったことでさらに効果 the composition introduced as the carrier gas or sheath gas inside a classifier, as a result, aerosol can be more efficiently received to a classifier.

> Simultaneously, since the mass of the medium gas in a DMA type classifier (carrier gas or sheathing gas) is large, the spatial dissipation by brown diffusion of the object ultrafine particle in a classification range is suppressed.

> Therefore, it also makes it possible to raise a sharpness of classification as a result.

【図面の簡単な説明】

[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS]

【図1】

本発明の実施の形態における微 Cross-sectional model of the microparticle 粒子分級装置の断面模式図

【図2】

アロゾル取込部周辺の拡大図

[FIG. 2]

[FIG. 1]

本発明の実施の形態におけるエ The expanded view of an aerosol taking-in section periphery in Embodiment of this invention

classifier in Embodiment of this invention

【符号の説明】

- エアロゾル分級部
- エアロゾル生成部

[Description of Symbols]

- 1 Aerosol classification section
- 2 Aerosol generation section

JP2000-146818-A

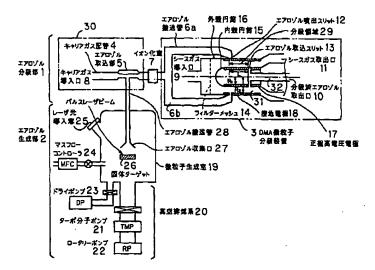


Ι	OMA微粒子分級装置	3	DMA microparticle classifier
		4	Carrier gas piping
		5	Aerosol taking-in section
٦	ニアロゾル搬送管	6	Aerosol conveyance pipe
1	イオン化室	7	Ionization chamber
4	テャリアガス導入口	8	Carrier gas inlet
દ	/一スガス導入口	9	Sheathing gas introduction port
)	分級済エアロゾル取出口	10	Classification settled aerosol output port
1	シースガス取出口	11	Sheathing gas output port
2	エアロゾル噴出スリット	12	Aerosol ejection slit
3	エアロゾル取込スリット	13	Aerosol taking-in slit
4	フィルターメッシュ	14	Filter mesh
5	内殼円筒	15	Inner-husk cylinder
3	外殼円筒	16	Outer-covering cylinder
7	正極高電圧電極	17	Positive-electrode high-voltage electrode
3	接地電極	18	Earth electrode
9	微粒子生成室	19	Microparticle generation chamber
С	真空排気系	20	Evacuation group
1	ターボ分子ポンプ	21	Turbo molecular pump
2	ロータリーポンプ	22	Rotary pump
3	ドライポンプ	23	Dry pump
4	マスフローコントローラ	24	Mass-flow controller
5	レーザ光導入窓	25	Laser-beam transduction window
6	固体ターゲット	26	Solid target
7	エアロゾル収集口	27	Aerosol collection mouth
3	エアロゾル搬送管	28	Aerosol conveyance pipe
9	分級領域	29	Classification range
С	エアロゾル取込み装置	30	Aerosol reception apparatus
	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 エアログルルター 1 フィルター 1 フィルター 1 フィルター 1 フィルター 1 内殻 1 円間 1 で 1 で 1 で 1 で 2 で 1 で 2 で 2 で 2 で 2 で	4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 3 14 15 6 7 8 9 10 1 12 3 14 15 6 7 8 9 10 1 12 3 14 15 6 7 8 9 10 1 12 3 14 15 6 7 8 9 10 1 12 3 14 15 6 7 8 9 10 1 12 12 13 14 15 6 7 8 9 10 1 12 12 13 14 15 16 7 8 9 16 17 8 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

【図1】

[FIG. 1]





- 1: Aerosol classification section
- 2: Aerosol generation section
- 3: DMA fine-particle classifier
- 4: Carrier gas piping
- 5: Aerosol taking-in section
- 6a: Aerosol conveyance pipe
- 7: Ionization chamber
- 8: Carrier gas inlet
- 9: Sheath gas introduction port
- 10: Classification completed aerosol output port
- 11: Sheath gas output port
- 12: Aerosol ejection slit
- 13: Aerosol taking-in slit
- 14: Filter mesh
- 15: Inner-husk cylinder
- 16: Outer-shell cylinder
- 17: Positive-electrode high-voltage electrode
- 18: Earth electrode
- 19: Fine-particle generation chamber
- 20: Evacuation -based
- 21: Turbo-molecular pump
- 22: Rotary pump
- 23: Dry pump



24: Mass-flow controller

25: Laser-beam introduction window

26: Solid target

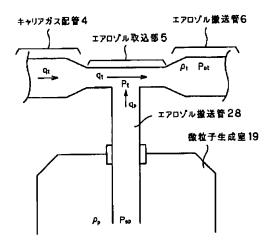
27: Aerosol collection mouth

28: Aerosol conveyance pipe

29: Classification region

【図2】

[FIG. 2]



4: Carrier gas piping

5: Aerosol taking-in section

6: Aerosol conveyance pipe

28: Aerosol conveyance pipe

19: Fine-particle generation chamber



DERWENT TERMS AND CONDITIONS

Derwent shall not in any circumstances be liable or responsible for the completeness or accuracy of any Derwent translation and will not be liable for any direct, indirect, consequential or economic loss or loss of profit resulting directly or indirectly from the use of any translation by any customer.

Derwent Information Ltd. is part of The Thomson Corporation

Please visit our home page:

"WWW.DERWENT.CO.UK" (English)

"WWW.DERWENT.CO.JP" (Japanese)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 許出顧公開番号 特開2000-146818 (P2000-146818A)

(43)公開日 平成12年5月26日(2000.5.26)

(51) Int.CL7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G01N 15/02

G01N 15/02

F

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号

特顧平10-314297

(22)出顧日

平成10年11月5日(1998.11.5)

(71)出願人 390010021

松下技研株式会社

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

冄

(72)発明者 吉田岳人

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(72)発明者 牧 野 俊 晴

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(74)代理人 100082692

弁理士 献合 正博

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微粒子分級方法及び装置

(57)【要約】

【課題】 減圧下で生成される粒径数nmレベルの超微 粒子を高精度で分級し、さらに高真空側の堆積室へ搬送 することが可能な分級装置を提供すること。

【解決手段】 微粒子生成室19のエアロゾル発生領域からこれを分級装置3へ、エアロゾルを差圧を利用して導入するに際し、エアロゾル発生領域の総圧に比較して、分級装置側に構成されたエアロゾル取り込み部の総圧を同等あるいは高く設定する。この構成で、エアロゾル取り込み部5のキャリアガス流速を大きくすることにより、取り込み部の静圧をエアロゾル発生領域の総圧より下げ、総圧としては同等かあるいは低いエアロゾル発生領域から、総圧としては同等かあるいは高い値をもつ分級装置内部に、エアロゾルを導入することができる。

PTO 2003-4370

S.T.I.C. Translations Branch

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エアロゾル発生領域で発生されたエアロゾルを分級装置へ差圧を利用して導入し、微粒子を分級するに際して、前記エアロゾル発生領域の総圧に比較して、前記分級装置側に構成されたエアロゾル取り込み部の総圧が、同等か或いは高くなるように設定したことを特徴とするエアロゾル中微粒子に対する微粒子分級方法

1

【請求項2】 エアロゾル発生領域で発生されたエアロ ゾルを分級装置へ差圧を利用して導入し、微粒子を分級 10 するに際して、前記分級装置側に構成されたエアロゾル 取り込み部が、特定のキャリアガスが流れる配管構造を しており、かつ前後の配管の径よりも細いことを特徴と するエアロゾル中微粒子に対する微粒子分級方法。

【請求項3】 エアロゾル発生領域で発生されたエアロゾルを分級装置へ差圧を利用して導入し、微粒子を分級するに際して、エアロゾル発生領域における媒質ガス種と異なった種類の媒質ガスが、分級装置内部のキャリアガスもしくはシースガスとして導入されることを特徴とするエアロゾル中微粒子に対する微粒子分級方法。

【請求項4】 エアロゾル発生領域における媒質ガスの 密度よりも高い密度を有する媒質ガスが、分級装置内部 のキャリアガスもしくはシースガスとして導入されることを特徴とする請求項3記載のエアロゾル中微粒子に対する微粒子分級方法。

【請求項5】 エアロゾル発生領域でエアロゾルを発生する段階と、発生されたエアロゾルを分級装置へ差圧を利用してエアロゾル取り込み部へ導入する段階と、エアロゾル取り込み部へ導入されたエアロゾルを微粒子分級部へ搬送する段階と、微粒子を分級する段階とから成り、

前記エアロゾルを分級装置へ導入するに際して、前記エアロゾル発生領域の総圧に比較して、前記分級装置側に 構成されたエアロゾル取り込み部の総圧が、同等か或い は高くなるように設定したことを特徴とするエアロゾル 中徴粒子に対する微粒子分級方法。

【請求項6】 ターゲット体にレーザビームを当ててエアロゾルを生成する手段と、生成されたエアロゾルを差圧を利用してエアロゾル分級手段へ取り込むエアロゾル取り込み手段と、エアロゾルから微粒子を分級する微粒 40 子分級手段と、エアロゾルをエアロゾル取り込み手段から微粒子分級手段へ搬送するエアロゾル搬送手段とから成り、

エアロゾル取り込み手段は、前記エアロゾル発生手段の 総圧に比較して、前記分級装置側に構成されたエアロゾル取り込み手段の部位の総圧が、同等か或いは高くなる ように設定されていることを特徴とするエアロゾル中微 粒子に対する微粒子分級装置。

【請求項7】 エアロゾル取り込み手段は、エアロゾル 生成手段とは分岐して延び、且つエアロゾル機送のため 50

のキャリアガスが流れるキャリアガス配管に接続されており、またエアロゾル取り込み手段の取り込み部位の配管の径は前後のキャリアガス配管の径よりも細く設定されていることを特徴とする請求項6記載のエアロゾル中微粒子に対する微粒子分級装置。

【請求項8】 微粒子分級手段は、エアロゾル発生領域 における媒質ガス種と異なった種類の媒質ガスが、微粒 子分級手段内部のキャリアガスもしくはシースガスとし て導入されるシースガス導入配管に接続されていること を特徴とする請求項6または7記載のエアロゾル中微粒 子に対する微粒子分級装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エアロゾル中の微粒子に対して気相で動作する微粒子分級装置であって、特にエアロゾル中の対象微粒子を荷電させ、さらに静電界を印加することで、粒径に依存した移動度の差を利用して分級する形式の微粒子分級装置に関するものである。

20 [0002]

【従来の技術】 微粒子分級装置の方式としては従来から 種々のタイプのものがあるが、第1の従来例として、電 気移動度分級法 (Differential Mobility Analyzing: D MA) について述べる。これは、エアロゾル中の微粒子を 分級するに際し、対象微粒子を荷電した後に静電界を印 加し、微粒子の大きさ (粒径)により媒質ガス中の移動 度が違うことを利用して行う分級法である。この技術に ついての詳細は例えば、ジャーナル・オブ・エアロゾル ・サイエンス、第28巻 (1997年)、193頁から 30 206頁 (J. Aerosol Sci. 28, pp193-206 (1997).) に記載されている。

【0003】第2の従来例として、微粒子線質量分級法(Particle Beam Mass Spectrometory: PBMS)について述べる。これは対象となる微粒子を封入した微粒子源から、高真空中に噴出する過程で微粒子を超音速線(ビーム)化する。次に、この微粒子線に電子線を照射することで荷電させ、同じく高真空中で電界を印加することで、微粒子の質量に応じた分級を行う方式である。この技術についての詳細は例えば、ジャーナル・オブ・エアロゾル・サイエンス、第26巻(1995年)、745頁から756頁(J. Aerosol Sci. 26, pp745-756 (1995).)に記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記第1の従来例では、元来大気圧のエアロゾルからサンプリングし分級することを前提に開発が始まったこともあり、分級装置内部の動作ガス圧が高く、最近の減圧型DMAでも50-100Torr以上の動作圧力が必要と考えられる。一方、機能材料化する目的で粒径数nm(ナノメートル)、特に10nm以下の超微粒子を物理

的気相中で生成するためには、ガス圧50Torr以下のできる限り質量の小さい希ガス雰囲気で行うことが望ましい。このように生成された超微粒子を、分級・堆積のプロセスを経て、機能材料として用いるためには、分級装置としてはより低圧での動作が可能なDMAが必要となってくる。何故なら、生成領域から分級装置にエアロゾルを流入させるためには、差圧導入を用いることが最も有効だからである。また、DMAの分級精度は、エアロゾル中対象微粒子のブラウン拡散の度合いにより決定されるため、生成領域で必要とされるような軽い希ガ 10スを媒質ガスとして用いることによって、劣化して行く傾向を持つ。

【0005】次に第2の従来技術によって、粒径数 n m の超微粒子を分級するためには、超微粒子を微粒子源からの噴出過程でビーム化するため流体力学的レンズの設計が困難になって来る。また、装置のサイズを常識的な範囲の装置の大きさに留めるかぎりは、分級部真空槽壁面の電気的接地が 0.1ボルト(V)以下の精度になる必要がある。

【0006】本発明は上記の課題に鑑みなされたもので 20 あって、減圧下例えば50Torr以下で生成される粒 径数nmレベルの超微粒子を効率よくサンプリングして 高精度の分級を行い、さらに高真空側の堆積室へ分級済 み超微粒子を搬送することが可能な、DMA型の分級装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明のDMA型分級装置は、エアロゾル発生領域からこれを分級装置へ差圧を利用して導入するに際し、エアロゾル発生領域の総圧に比較して、分級装置側に構 30成されたエアロゾル取り込み部の総圧が、同等あるいは高く設定されている。この構成で、分級装置にエアロゾルを取り込むためには、取り込み部のキャリアガス流速を大きくすることにより、静圧を下げる必要がある。これにより、取り込み部の静圧をエアロゾル発生領域の総圧より下げることができれば、総圧としては同等かあるいは低いエアロゾル発生領域から総圧としては同等かあるいは高い値をもつ分級装置内部に、エアロゾルを導入することができる。

【0008】また、本発明のDMA型分級装置は、分級 40 装置側に構成されたエアロゾル取り込み部が、特定のキャリアガスが流れる配管構造をしており、かつ前後の配管の径よりも細く設定されているため、エアロゾル取り込み部における局所的キャリアガスの流速が高まる構造となっている。これにより、分級装置側エアロゾル取り込み部の静圧をより効果的に下げることを可能としている

【0009】さらに、本発明のDMA型分級装置は、エ アロゾル発生領域における媒質ガス種と異なった種類の 媒質ガス、特にエアロゾル発生領域における媒質ガス種 50

より質量の大きい媒質ガスが、分級装置内部のキャリアガスもしくはシースガスとして導入される構成をとっている。これにより、さらに効果的に分級装置のエアロゾル取り込み部の静圧を下げることになり、ひいてはより効率的にエアロゾルを分級装置に取り込むことができる。それと同時に、DMA型分級装置内における媒質ガス(キャリアガスもしくはシースガス)の質量が重いことは、分級領域での対象超微粒子のブラウン拡散を抑制するのである。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、エアロゾル発生領域からエアロゾルを分級装置へ差圧を利用して導入する方式のDMA微粒子分級方法において、エアロゾル発生領域の総圧に比較して、分級装置関に構成されたエアロゾル取り込み部の総圧が、同等あるいは高く設定されている。この構成で、分級装置にエアロゾルを取り込むために、取り込み部にキャリアガスを大きな流速で流す構造とすることにより、取り込み部の静圧をエアロゾル発生領域の総圧より下げることができれば、総圧としては同等かあるいは低いエアロゾル発生領域から、総圧としては同等かあるいは高い値をもつ分級装置内部に、エアロゾルを導入することが可能となる。

【0011】ここで、請求項2に記載のように、分級手段側に構成されたエアロゾル取り込み部が、特定のキャリアガスが流れるようになっており、かつエアロゾル取り込み部位の径は、その前後の配管の径よりも細く設定されているため、エアロゾル取り込み部における局所的キャリアガスの流速が高まる構造となっている。これにより、分級装置側エアロゾル取り込み部の静圧をより効果的に下げることを可能としている。

【0012】さらに、請求項3、4に記載のように、エアロゾル発生領域における媒質ガス種と異なった種類の媒質ガス、特にエアロゾル発生領域における媒質ガス種より質量の大きい媒質ガスが、分級手段内部のキャリアガスもしくはシースガスとして導入される構成をとっている。これにより、さらに効果的に分級装置のエアロゾル取り込み部の静圧を下げることなり、延いてはより効率的にエアロゾルを分級装置に取り込むことができる。

同時に、DMA微粒子分級装置内における媒質ガス(キャリアガスもしくはシースガス)の質量が重いために、分級領域での対象超微粒子のブラウン拡散による空間的 散逸を抑制するので、結果として分級精度が上がること にも繋がる。

【0013】(実施の形態)次に、本発明における実施の形態について説明をする。図1に、本実施の形態における微粒子分級装置の断面模式図を示す。図1は大きく分類して、エアロゾル中の微粒子を分級するエアロゾル分級部1と、微粒子を含むエアロゾルを生成(発生)するエアロゾル生成部2により構成されている。さらに、

5

エアロゾル分級部1は2重円筒微分形DMA微粒子分級 装置本体3、エアロゾル取込部5、エアロゾル搬送管6 などから構成されている。

【0014】エアロゾル生成部2は微粒子生成室19と その真空排気系20などから構成されている。 エアロゾ ル生成部2は、微粒子を含むエアロゾルを生成するため の本体となる微粒子生成室19と、微粒子生成室19に 設けられ微粒子生成室20内に設置された固体ターゲッ ト26に向けてパルスレーザビームを導入する導入窓2 5と、固体ターゲット26から放出されたエアロゾルを 10 エアロゾル分級部2へ送給する第1のエアロゾル搬送管 28とから構成され、第1のエアロゾル搬送管28の一 端は微粒子分級生成室19内の固体ターゲット26設置 部分まで延びてこの先端にエアロゾルを収集するエアロ ゾル収集口27が設けられている。微粒子生成室19に は、真空排気系20としてターボ分子ポンプ21と、ロ ータリーポンプ22とが接続されている。また微粒子生 成室19には、この微粒子生成室の内部を乾燥させるた めのトライポンプ23が接続されるとともに、マスフロ ーコントローラ24が接続されている。

【0015】エアロゾル分級部1は大きく分けて微粒子 生成部2において生成されたエアロゾルを取り込むエア ロゾル取込み装置30と、取り込まれたエアロゾルから 微粒子を分級する微粒子分級装置3とから構成されてい

【0016】エアロゾル取込み装置30は、上記第1の エアロゾル搬送管28の他端に連結されエアロゾル生成 室19から送給されたエアロゾルを取り込むエアロゾル 取込部5と、一端がエアロゾル取込部5に接続されたキ ャリアガス配管4と、キャリアガス配管4とは反対側に 30 おいて一端がエアロゾル取込部5に接続されエアロゾル 取込部5に取り込まれたエアロゾルを微粒子分級装置3 へ向けて送給する第2のエアロゾル搬送管6とから構成 されている。このエアロゾル取込み装置30は図2に拡 大して示すように、エアロゾル取込部5、キャリアガス 配管4、第2のエアロゾル搬送管6の部分がいずれも管 状体から構成されており、キャリアガス配管4およびエ アロゾル搬送管6の直径に比べてエアロゾル取込部5の 直径が小さな寸法に設定されている。また、キャリアガ ス配管4の他端にはキャリアガス導入口8が設けられ、 このキャリアガス導入口8からはキャリアガスがエアロ ゾル取込部5の方へ向けて送り込まれる。キャリアガス はエアロゾル取込部5に取り込まれたエアロゾルを微粒 子分級装置3へ向けて搬送する役割を持つ。 なお、 エア ロゾル取込み装置30と微粒子分級装置3との間にはエ アロゾルをイオン化するイオン化室7が設けられてい

【0017】この実施の形態において、微粒子分級装置 3にはDMA微粒子分級装置が採用されている。この微

と、外殻円筒16の内部に配置された内殻円筒15と、 先に述べた第2のエアロゾル搬送管6とから構成されて いる。外殼円筒16は、基端部(後端部:エアロゾルの 流れる方向先方を前方或いは先方とし、逆方向を後方と する) および先端部が開放された筒状体から成り、基端 部には外殻円筒16から段差状に縮径したシースガス導 入口9が設けられている。 また、 外殻円筒16の長手方 向中間部の内部には、当該外殻円筒16と内殻円筒15 との間に出来た隙間により通路31が形成され、この通 路31の先方にはシースガス取出口11が設けられてい る。さらに、外殻円筒16の長手方向中間部の側面の複 数箇所には、当該外殻円筒16の内外を連通する微細な 隙間により成るエアロゾル噴出スリット12が形成され ている。

【0018】内殻円筒15は外殻円筒16よりも小さな 径を持つ筒状体から成り、その後端部は密閉される一 方、先端部は開放されたキャップ構造を有している。ま た、内殻円筒15の先端寄り部分の側面の複数箇所に は、通路31と内殻円筒15の内部とを連通する微細な 20 隙間により成るエアロゾル取込スリット13が形成され ている。さらに、内殻円筒15は、その先端部分におい て上記エアロゾル取込スリット13部分から先方へ延び るエアロゾル取出管32に接続され、このエアロゾル取 出管32の先端には分級済のエアロゾルが取り出される エアロゾル取出口10が形成されている。

【0019】第2のエアロゾル搬送管6は、微粒子分級 装置3部分においては、分岐して複数(図1では2つ) の分岐管6a、6bになり、両分岐管6a、6bの先端 は外殼円筒16の側面に形成されたエアロゾル噴出スリ ット12に外側から接続されている。

【0020】本実施の形態では、シリコン(Si)やゲ ルマニウム(Ge)など高純度半導体の固体ターゲット 26に、パルスレーザビームを集光照射することで、固 体ターゲット26の表面からアブレート (脱離・射出) されたイオン・原子・クラスタを、ヘリウム (He) な どの希ガスが充満した物理的気相中で再凝縮させること で微粒子化させる。このとき、生成される微粒子の粒径 分布は、ターゲット材料種、パルスレーザビームの照射 条件(波長、パルス幅、エネルギー密度)、希ガス圧 40 力、ターゲットからの距離・方向などによって変化す る。粒径分布に最も大きな影響を与えるのは、希ガス圧 力である。半導体固体材料としてSi、希ガスとしてH eを用いた場合、概ねガス圧が、3-20Torrで、

【0021】さらに具体的に本実施の形態におけるナノ 微粒子の生成方法について述べる。微粒子生成室19 は、表面露出原子数の大きいナノ微粒子(粒径5 nmで は約40%が表面露出原子となる)が酸化や不純物汚染 粒子分級装置3は、装置本体となる筒状の外殼円筒16 50 に極めて敏感であることから、超高真空対応に電界研磨

粒径が数nmから数10nm、最大でも50nmの、い

わゆるナノ微粒子が形成される。

を施されたSUS304合金を用いて構成されている。 接続される各バルブ・フランジも200℃ベークが可能 な超高真空対応品を使用している。この微粒子生成室1 9を、ターボ分子ポンプ21を主ポンプ、ロータリーポ ンプ22をバッキングポンプとして排気することによ り、到達真空度として、10⁻¹⁰ Torr台を達成して いる。ナノ微粒子生成時には、マスフローコントローラ 24を介して高純度半導体プロセス用Heガス (純度9 9.9999%以上)を200sccmの一定流量で導 入する。マスフローコントローラ24及び高純度半導体 10 プロセス用Heガス導入配管系はEPグレードの高純度 対応品を使用している。この場合は、ターボ分子ポンプ 21ではなく、ドライポンプ23により差動排気するこ とにより、一定のHe雰囲気圧10.0Torrを保っ

7

【0022】上述の減圧He雰囲気において、微粒子生 成室19に設置され、8rpm (回転/分)の角速度で 自転している固体ターゲット26に、パルスレーザビー ムを石英製のレーザ光導入窓25を通して集光照射する ことで、固体ターゲット26の表面においてアブレーシ ョンを起こす。ここで、固体ターゲット26としては高 純度Si 単結晶基板(面方位(100)、比抵抗10Ω・ cm)を使用した。パルスレーザビームの集光照射として は、Q-スイッチNd:YAGレーザの第2高調波(波 長:532nm、パルスエネルギー:10mJ、パルス 幅:40ns、繰り返し周波数:10Hz)を、固体タ ーゲット26の表面上で10J/cm2のエネルギー密 度になるよう集光照射している。

【0023】固体ターゲット26の表面からアブレート (脱離・射出) されたSi種 (イオン・原子・クラス タ)は、雰囲気Heの原子と衝突を繰り返すことにより 当初の射出運動エネルギーを雰囲気Heガスへ散逸しつ つ、Si種どうしの会合が促進されることで、物理的気 相中での凝縮すなわちナノ微粒子生成が起こる。このと き、生成されるナノ微粒子の粒径分布は、ターゲット材 料種、パルスレーザビームの照射条件(波長、パルス 幅、エネルギー密度)、ターゲットからの距離・方向、 雰囲気希ガス圧力などによって変化する。

【0024】粒径分布に最も大きな影響を与えるのは雰 囲気希ガス圧力である。これがある閾値を下回ると急激 40 に気相でのナノ微粒子生成はなされにくくなり、射出S i種の大半は堆積基板上で非晶質Si薄膜として凝縮す るようになる。この閾値は、材料としてSiとHeを用 い、レーザとしてパルス幅が数から数十nsのQ-スイ ッチレーザを用いた場合、3-5Torr付近にある。 また、雰囲気希ガス圧力がこの閾値を超えて高くなり過 ぎると、ナノ微粒子どうしの凝集が急激に発生し出し、 見かけ上20 nm以上の微粒子が生成されたり、さらに これらがブドウの房状に凝集したものが多数見受けられ るようになる。これは、射出Si種の雰囲気希ガスによ 50

る閉じ込め効果(プルームの閉じ込め効果)が顕著にな ることで射出Si種の空間密度が上がり過ぎるためであ る。

【0025】そこで、本実施の形態では、ナノ微粒子生 成が起こる上でなるべく低い雰囲気He圧力として、1 Torrを設定した。また、固体ターゲット2 6表面からの距離が長くなるにつれても微粒子の成長が 促進される傾向がある。したがって、本実施の形態で は、固体ターゲット26表面の鉛直上3.0 cm にエア ロゾル収集口27を設け、気相で生成したナノ微粒子を 雰囲気Heガスとともにエアロゾルとして引き出すこと により、運動エネルギーを散逸させて気相に滞留するこ とで不要な凝集による大粒化を抑制している。ここで収 集されたSiナノ微粒子を含有しHeガスを媒質ガスと するエアロゾルは、エアロゾル搬送管28を通って、エ アロゾル分級部1のエアロゾル取込部5に流入する。 【0026】本実施の形態のDMA微粒子分級装置3で は、エアロゾル生成部2の総圧に比較して、エアロゾル 分級部1側に構成されたエアロゾル取込部5の総圧が、 20 同等あるいは高く設定されている。この構成で、DMA 微粒子分級装置3にエアロゾルを取り込むために、エア ロゾル取込部5にキャリアガスを大きな流速で流す構造 とすることにより、エアロゾル取込部5の静圧を下げて いる。これにより、エアロゾル取込部5の静圧をエアロ ゾル発生領域の総圧より下げることができれば総圧とし ては同等かあるいは低いエアロゾル発生領域から、総圧 としては同等かあるいは高い値をもつDMA微粒子分級

【0027】上述の構成によって、Siナノ微粒子とH 30 e媒質ガスからなるエアロゾルが、エアロゾル搬送管2 8を通って、エアロゾル分級部1のエアロゾル取込部5 に流入する機構を、エアロゾル取込部5周辺の拡大図 (図2)を用いて若干詳しく説明する。

装置3内部に、エアロゾルを導入することが可能とな

【0028】対象エアロゾルがエアロゾル搬送管28を 通って、エアロゾル分級部1のエアロゾル取込部5に導 入されるよう緒条件を設計するためには、総圧 (popと する) なる微粒子生成室19及びエアロゾル搬送管28 から、静圧 (pt とする) なるエアロゾル取込部5への 流入状況を流体力学的に解析する必要がある。図2に示 すように、微粒子生成室19の内部における実質的流速 は無視でき、エアロゾル取込部5内部では、流速(qt とする) の層流があるとしている。ここで一般に、媒質 の静圧p、総圧p。、密度ρ、流速qの間には流体力学の ベルヌーイの定理から、次の第(1)式で表わされる関 係が成り立っている。

【数1】

る。

$$P + \frac{\rho q^2}{2} = P_0$$

9

\cdots (1)

【0029】以降、添え字「p」が微粒子生成室19の 内部を、添え字「t」がエアロゾル取込部5の内部を示 すものとする。これに気体分子運動論的解析を加味する* *ことにより、エアロゾル搬送管28からエアロゾル取込部5への流入速度 qp の2乗を、次の第(2)式で表現することができる。

10

これに気体分子運動論的解析を加味する*
$$\mathbf{q_p}^2 = \frac{2 \gamma}{\gamma - 1} \frac{\mathbf{P_{op}}}{\mathbf{P_p}} \left\{ 1 - \left(\frac{\mathbf{P_{oi}} - \frac{\mathbf{P_i} \mathbf{q_i}^2}{2}}{\mathbf{P_{op}}} \right)^{(p-1)/\gamma} \right\}$$

\cdots (2)

【0030】ここででは媒質ガスの比熱比で気体分子の 構造によって決まるものである。Ar(アルゴン)やH eなどの希ガス (単原子気体)では、気体の種類によら ず1667である。本実施の形態では、キャリアガスと して、総圧25TorrのArを、微粒子生成室19側 のエアロゾル媒質ガスとして、総圧10TorrのHe を採用している。この設定においては、エアロゾル取込 部5での流速gt が、260m/sに到達すると、エア ロゾル搬送管28からエアロゾル取込部5への流入が可 能となる。また、エアロゾル取込部5での流速 qt には 20 る。 上限があって、その値は336m/sである。また、エ アロゾル搬送管28からエアロゾル取込部5への流入流 速 qp にも上限があって、その値は1680m/sであ る。なお上記2種類の流速上限値は圧力設定にはよら ず、気体種類 (分子量、分子構造) と温度のみにより決 まるもので、正しく音速である。

【表1】

キャリアガス流速 q.	Q ₂ ²
キャリアガス密度 ρ.	ρ_{ι}
キャリアガス総圧 pa	-p _{0t}
エアロゾル媒質ガス密度 ρ,	$\rho_{\mathfrak{p}}^{-1}$
エアロゾル媒質ガス総圧 pop	Pop

【0032】本実施の形態では、キャリアガスArの流量を2.01/min(標準状態)と設定している。エアロゾルの取り込みにおいては、前述のようにこの流量が多いほど有利であるが、後述するように、あまり上げてしまうとシースガスとの比率が上がることで、分級分解能が低下してしまうからである。エアロゾル取込部5において、この流量(2.01/min)を先の流速す

10%ると、エアロゾル取込部5の径は、2.5mmとすべき ことが導かれる。キャリアガス配管4としては、クリー ン度が高いEP管の入手し易さと、配管全体のコンダク タンス確保の必要性から、内径4.3mmの1/4イン チ配管を使用しているため、エアロゾル取込部5では図 2に示すようにくびれ構造をとっている。ここで、エア ロゾル取込部5でのキャリアガス流速 qtを上限速度3 36m/sの80%と設定すると、エアロゾル搬送管2 8からエアロゾル取込部5への境界領域での流入流速 q p は、338m/sとなり実用上充分な値が確保され

【0033】上述の機構で、エアロゾル分級部1のうちエアロゾル取込部5に導入されたエアロゾルは、生成当初はSiナノ微粒子とHe媒質ガスから構成されていたが、キャリアガス導入口8から導入されるキャリアガスであるアルゴン(Ar)と混合されるため、媒質ガスがAr+Heの混合ガスであるエアロゾルとなって、DMA微粒子分級装置本体3に向かって搬送され始める。次に、イオン化室7を通過する際に内部に設置された放射性同位体アメリシウム(241 Am)の発する放射線により、Siナノ微粒子が荷電する。この時の荷電率は、ナノ微粒子の粒径とエアロゾル搬送管6内部の圧力(主に総圧)に依存するが、本実施の形態では粒径5nmのSiナノ微粒子に対して、約10-5の率で1値に荷電することができる(圧力10-100Torrを想定)。

【0034】エアロゾル搬送管6はDMA微粒子分級装置本体3に流入する前に、対称な形で2系統に分岐される。DMA微粒子分級装置本体3は、2重円筒微分形DMAの形式である。これは同心状に配置された内殻円筒15と外殻円筒16を基本に構成されている。2系統に40分岐されたエアロゾル搬送管6は、2重円筒構造の共通中心軸に対称な形状で、DMA微粒子分級装置本体3に接続されている。その他に、DMA微粒子分級装置本体3には、シースガス専入口9、分級済みエアロゾル取出口10、シースガス取出口11が接続されている。ここで、シースガス取出口11は、エアロゾル搬送管6と同様に、2重円筒構造の共通中心軸に対称な形状で接続されている。

解能が低下してしまうからである。エアロゾル取込部5 【0035】ここで、DMA微粒子分級装置本体3の動において、この流量(2.01/min)を先の流速q 作の概略を説明する。先ず、シースガス導入口9より、 t 上限速度336m/sの80%で達成するよう設定す※50 シースガスとしてArガスが、201/minの流量で *が軌跡を決定している。これらのパラメータを適切に設 定することにより、特定の粒径の微粒子を分級済エアロ ゾル取出口10から抽出することができる。 すなわち分 級を行うことが可能となる。通常は、横方向搬送速度と 幾何学形状の設定により、分級後粒径の中心値を決定し ておき、最後に静電界強度(ソフト的なパラメータとし て)を調整することで、ある範囲では任意の分級後粒径

12

ュ14を介して、外殻円筒16と内殻円筒15との空間 (ここが狭義での分級領域29になる)に流入すること で、分級領域29では効果的に層流となることができ る。流入するシースArガスにほぼ等しい流量が、シー スガス取出口11から大型メカニカルブースターポンプ が接続されたロータリーポンプにより排出される。一 方、媒質ガスは、Ar+ Heの混合ガスから成ってお り、Siナノ微粒子を含有するエアロゾルはDMA微粒 形状に分岐した、エアロゾル搬送管6から、エアロゾル 噴出スリット12を通って、分級領域29に導入され

【0038】現実には、この際の分級精度が、有限のス 子分級装置本体3の2重円筒構造の共通中心軸に対称な 10 リット幅、シースガス中におけるナノ微粒子のブラウン 拡散の影響により、分級後も有限の粒径分布幅を持つこ とになる。本実施の形態では、分級領域幾何学形状とし $T, L: 20mm, R_1: 25mm, R_2: 35mm$ 、シースガスとして、Arガスを201/min、印 加電圧を1-200Vの範囲で可変とし、-1値に荷電 したSiナノ微粒子を対象とすることで、粒径中心値を 5-10 nmの範囲で任意に決定でき、分級後の粒径分

を選ぶことができる。

【0036】分級領域29では、内競円筒15の外壁に 貼りつけられた正極高電圧電極17と、外殻円筒16の 内壁に貼りつけられた接地電極18により、共通中心軸 に放射状の静電界を印加されている。エアロゾル噴出ス リット12から分級領域29に導入された荷電されてい ないSiナノ微粒子は、層流状のシースガスの流れに乗 口11の方向(図1の中では左から右)に搬送され、シ ースガス取出口11から排出される。イオン化室7にて 荷電されたSiナノ微粒子は分級領域29に形成された 静電界により偏向する。特に負に荷電されたSiナノ微 粒子は、内殻円筒15の側に引き寄せられ、一部はエア ロゾル取込スリット13を経て、分級済エアロゾル取出 口10から取り出すことができる。

布幾何標準偏差が1.2を実現している。 【0039】ここで、シースガスとしてArガスを用い って、エアロゾル噴出スリット12からシースガス取出 20 るのは、Heの1.68倍の分子径σ、同じく1.13 倍の粘性率μを持つため、同じ流量でも分級の分解能を 向上させることができるからである。しかも、希ガスの 中では最も安価である。2重円筒微分形DMA分級装置 においては、シースガスの分子径σ及び粘性率μを大き く設定することにより、分級分解能を極めて有効に向上 させることができる。これは、2重円筒微分形DMA微 粒子分級装置の分級領域におけるエアロゾル(微粒子と 媒質ガス:キャリアガスとシースガス)の挙動を、気体 分子運動論に基づくブラウン拡散現象として解析するこ スガスによる横方向搬送速度、静電界強度分布、幾何学 30 とにより得られた、分級後における粒径分布の相対半値 全幅FWHMの2乗を表現する次の第(3)式の関係式 で説明することができる。

【0037】分級領域29での荷電微粒子の軌跡は、原 理的には、荷電微粒子のシースガス中での移動度、シー 形状(分級長L、内殼円筒径R1、外殼円筒径R2)な どにより決定される。実際の動作パラメータとして、シ ースガスの種類・流量、荷電微粒子の大きさ・価数など*

【数3】 FWHM² =const. × $\frac{\left(b + \frac{1}{b}\right) \frac{R_1}{R_2} (R_1 + R_2) (kT)^2}{\mu \cdot \sigma^2 \cdot Q \cdot P \cdot d_p^2}$

$$b = \frac{L}{R_2 - R_1} \quad \text{, const.} \cong 2. 784$$

 \cdots (3)

【0040】分級分解能が相対半値全幅PWHMの逆数に比 例するものであるとし、第(3)式を活用することで、 シースガスの分子径σ、粘性率μの他にも、シースガス 流量Q、分級動作圧力p、分級動作温度Tなどの分級動※ ※作パラメータの、分級分解能への依存性を導くことがで きる。この結果を (表2) にまとめておく。kはボルツ マン定数である。

【表2】

13

 Q^{as} シースガス流量 0 p as 動作圧力 p シースガス分子径 σ σ 微粒子の粒径 🛦 ፈ T^{-1} 動作温度 7

に必要な軽いHeガスとは別に、シースガスとしては重 いArガスを用いているのは、分子径σを大きくとるこ とによって、分級分解能を向上させる意図がある。ま た、シースガス流量Qもできるだけ大きく設定して分級 分解能向上に寄与させている。分級動作圧力pは、Si ナノ微粒子生成時のHeガス圧力が低いため(10.0 Torr) むやみには高くできない。すなわち、エアロ ゾル取込部5の機構に制限される。さらに、動作温度で あるが、これを低く設定することが分級分解能向上に有 効ではあるが、現実的に装置全体を冷却することには大 20 3 DMA微粒子分級装置 きなコストがかかるので、室温動作としている。最後 に、対象微粒子の粒径は。であるが、これが小さくなる につれて分級分解能が低下する傾向にある。数nm、特 に5nm以下のナノ微粒子を対象とするDMA分級装置 の設計には細心の注意が必要とされる。

[0042]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、エアロ ゾル発生領域からこれを分級装置へ差圧を利用して導入 する方式のDMA型分級装置において、総圧としては同 等かあるいは低いエアロゾル発生領域から、総圧として 30 13 エアロゾル取込スリット は同等かあるいは高い値をもつ分級装置内部に、エアロ ゾルを導入・分級することが可能となる。ここで、分級 装置側に構成されたエアロゾル取り込み部が、特定のキ ャリアガスが流れる配管構造をしており、かつ前後の配 管の径よりも細く設定したことで、分級装置側エアロゾ ル取り込み部の静圧をより効果的に下げることを可能と している。

【0043】また、エアロゾル発生領域における媒質ガ ス種と異なった種類の媒質ガス、特にエアロゾル発生領 域における媒質ガス種より質量の大きい媒質ガスが、分 40 23 ドライポンプ 級装置内部のキャリアガスもしくはシースガスとして導 入される構成をとったことでさらに効果的に分級装置の エアロゾル取り込み部の静圧を下げることなり、ひいて はより効率的にエアロゾルを分級装置に取り込むことが できる。同時に、DMA型分級装置内における媒質ガス (キャリアガスもしくはシースガス)の質量が大きいた めに、分級領域での対象超微粒子のブラウン拡散による*

【0041】本実施の形態では、Siナノ微粒子生成時 10*空間的散逸を抑制するので、結果として分級精度を上げ ることも可能としている。

14

【図面の簡単な説明】

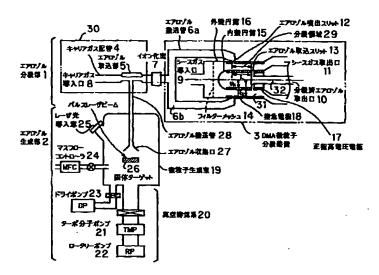
【図1】本発明の実施の形態における微粒子分級装置の 断面模式図

【図2】本発明の実施の形態におけるエアロゾル取込部 周辺の拡大図

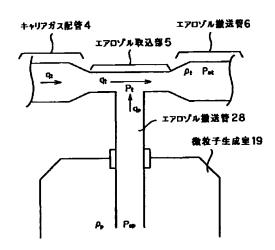
【符号の説明】

- 1 エアロゾル分級部
- 2 エアロゾル生成部
- - 4 キャリアガス配管
 - 5 エアロゾル取込部
 - 6 エアロゾル搬送管
 - 7 イオン化室
 - 8 キャリアガス導入口
 - 9 シースガス導入口
 - 10 分級済エアロゾル取出口
 - 11 シースガス取出口
 - 12 エアロゾル噴出スリット
- - 14 フィルターメッシュ
 - 15 内殼円筒
 - 16 外殼円筒
 - 17 正極高電圧電極
 - 18 接地電極
 - 19 微粒子生成室
 - 20 真空排気系
 - 21 ターボ分子ポンプ
 - 22 ロータリーポンプ
- - 24 マスフローコントローラ
- 25 レーザ光導入窓
- 26 固体ターゲット
- 27 エアロゾル収集日
- 28 エアロゾル搬送管
- 29 分級領域
- 30 エアロゾル取込み装置

【図1】



【図2】



フロントページの続き

m in 10

(72)発明者 鈴 木 信 靖 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1 号 松下技研株式会社内 (72)発明者 山 田 由 佳 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1 号 松下技研株式会社内